光流体サ-ボシステムの開発と応用に関する研究

メタデータ	言語: jpn
	出版者:
	公開日: 2012-05-24
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 吉満, 俊拓
	メールアドレス:
	所属:
URL	http://hdl.handle.net/10291/12911

明治大学大学院 理工学研究科

(1)

1999年度

博士学位請求論文

光流体サーボシステムの開発と応用に関する研究

Study on Development and Application of Opto-fluidic Servo System

学位請求者 機械工学専攻

吉満 俊拓

目次

第1章 序論

第2章	流体サ	ーボシステムの開発			
	2.1	はじめに	7		
	2.2	流体サーボによる圧力制御	11		
		2.2.1 電磁弁による駆動	12		
		2.2.2 電磁弁を用いた圧力制御	18		
	2.3	流体サーボによる流量制御	28		
		2.3.1 等温化圧力容器を用いた流量測定	28		
		2.3.2 圧力変動を用いた流量制御	30		
	2.4	流体サーボによる位置制御	37		
		2.4.1 電磁弁を浮動状態とさせて用いた空気圧位置制御	37		
		2.4.2 サーボ弁を用いた空気圧位置制御	43		
		(空気圧アクチュエータの粘弾性を考慮した制御)			
	2.5	まとめ	53		
第3章	光流体変換器の開発				
	3.1	はじめに	54		
	3.2	システム構成	55		
		3.2.1 層流比例増幅素子	55		
		3.2.2 光流体変換器	55		
	3.3	光流体変換器の特性	58		
		3.3.1 数値流体解析法を用いた速度・温度分布解析モデル	58		
		3.3.2 出力特性	62		
	3.4	実験結果	73		
		3.4.1 光流体変換器の製作	73		
		3.4.2 光流体変換器の温度・速度分布解析	74		
		3.4.3 光流体変換器の変換特性	75		
	3.5	まとめ	87		
第4章	光流体	サーボシステムの開発と応用			
	4.1	はじめに	88		
	4.2	膜型流体増幅器を使ったロボットアーム制御システム	88		
		4.2.1 システム構成	88		
		4.2.2 位置制御の実験結果	93		
	4.3	サーボ弁を用いた圧力制御システム	108		
		4.3.1 システム構成	108		
		4.3.2 実験結果	108		
	4.4	まとめ	115		
第5章	結論		116		

1

参考文献

謝辞

第1章 序論

我々人間にもっとも関わりのあるクリーン媒体つまり地球上に無限に存在す る流体を使って仕事をさせる歴史は古く,水や空気蒸気などを用いて力を発生 したり物を動かしたりするアイディアは有史以前になると考えられている.産 業界に広く認識されるのは産業革命以後であり,工場に加圧した水や空気を配 給するプラントが稼動していた.現在流体アクチュエータは産業用にかかせな い存在であり,重作業用に鉱油,軽作業用に空気をそれぞれ媒体とすることが 多い.これらのアクチュエータが電動式アクチュエータと併用して使用される 理由は,重量対出力比が大きいことと,独特な動作特性を持ち作業によっては 代替ができないためである.ただし流体アクチュエータの使用量が飛躍的に伸 びたのは電子制御を可能とする電磁弁やサーボ弁の開発が行われFA化に適する ようになったからである.

近年,流体アクチュエータの柔軟な特性,安全性などが注目され,医用や介 護福祉に利用する試みが盛んである.ゴム人工筋アクチュエータを利用した抱 き上げマニピュレータ¹¹や,同じくゴム人工筋を用いたリハビリテーション支援 ロボット²⁰,看護婦支援サポートカー³⁰,空圧式ホームエレベーター⁴⁰,インテ リジェント義足⁵⁰,歩行支援機⁶⁰,介護用パワードスーツ¹⁰などである.これら の機器はすべて電磁弁やサーボ弁を使って操作されているが機器の性格上種々 のフィールドで使用されるので外来のノイズによる誤動作への配慮,使用者に 接触することの安全性などから,より信頼性の高い信号媒体の利用が課題とな っている.電子工学の驚異的な進歩により現在はあらゆる機械に電子機器が含 まれており,流体力を利用する制御装置も電気信号を介しているものが一般的 である.しかし,周囲の温度が激しく変化したり,放射能や電磁気ノイズなど が存在する極限環境下では媒体に電気信号を用いると正常に作動しない恐れが ある.

耐環境性に優れた制御システムの信号媒体として光があげられる.光を信号 とする技術の歴史も同様に古く「のろし」や「点滅信号」などから現在では情報通

信の媒体として中心的な役割を得ている。光は電磁気の影響を受けず人にも安 全であることから流体制御の信号媒体として以前より注目されてきた.工場な どにおいてもコンピュータによる情報ネットワークを利用した FA システムに適 合するからである.しかし、光で直接流体の圧力、流量などの物理量を変える 原理は発見されておらず現在は次の2つの方法が知られているのみである.ま ず、光により変形する固体を一次アクチュエータとして用いこのアクチュエー タによって流体圧の変化を誘導する方法がある⁸⁰. 固体としてバイモルフ構造を した光圧電性機能セラミックスが使われるが、変形の応答速度が遅く実用的な レベルに達していない、次に、光を一度熱に変え熱により流体の物理量を変え る方法がある.有名な研究にベル研による光音響効果⁹があり.熱吸収体を詰め た空気空洞に音声信号で変調した光を照射すると、空洞内の空気の膨張圧縮に よる圧力変化が音として聞こえる. デジタル方式の光流体変換方式として Gurney らはフルイディクスの流体流路にパルス状の光を照射することにより光 信号の周波数に対応した圧力変化を作り出している¹⁰⁰. さらに、Drzewiecki ら はこの光流体変換器をミサイル迎撃用ロケットの制御に利用する提案 ¹¹⁾を行っ ている、この変換方法はきわめて高速の光流体が可能だが、光信号の強さに対 応する圧力の発生などアナログ的利用はできない. 堂田 ¹²⁾らはフルイディクス の流路壁の一部に直接光で照射する方式によりアナログ的な光流体変換をおこ なった.山本 ¹³らはフルイディクスの流路壁の一部に光吸収体を塗り光ファイ バを通して、温度境界層を制御することによりアナログ的な光流体変換が可能 であることを示した.本研究は基本的に山本らの方法を用いたものであるが, 光流体変換器の最適設計のため従来解析が行われていなかったフルイディクス 内部の流れ場および温度を理論および実験により明らかにする. また光流体制 御の実用化を目指して空気圧アクチュエータや圧力回路の光による直接制御を 可能とするものである.

流体アクチュエータの中でもっと利用されているのが,空気圧シリンダである.しかし,動作媒体である空気の圧縮性に起因して操作遅れが生じ,オーバシュートまたはアンダーシュートを起こしやすい.また,空気漏れを防止するためにゴム材などを使用したシールがシリンダ内部に取り付けられているが,

 $\mathbf{2}$

この非線形摩擦及びその不均一性のために中間位置での位置決めや速度制御は 困難であるとされてきた.現実の空気圧システムはオンオフ弁と空気圧シリン ダにより2点間動作をするものがほとんどである.しかし,エレクトロニクス 技術の発達と空気圧サーボ弁の開発によって,フィードバック制御を用いた空 気圧サーボシステムが実現化してきている¹⁴⁾¹⁵⁾.

本研究は光流体サーボシステムの実用化を目的としたものであるが,第2章で はまず、流体制御システムの有用性を確認するため従来用いられている電磁弁 やサーボ弁により駆動される空気圧レギュレータの圧力精度や空気圧シリンダ の位置決め精度を例に上げその性能改善整備を行う. 空気圧シリンダの変位は シリンダの内圧に支配されており、サーボアクチュエータとして高精度な位 置・速度動作をさせるためには高精度・高応答な圧力制御が必要となる.しか し、圧力制御用として従来広く使用されている膜型空気圧レギュレータのよう な受動型のレギュレータでは,供給圧力・負荷条件の変化に伴う精度の変化や, 設定圧力へ回復するまでに時間がかかるなどの問題がある. 一方同じくシリン ダ制御用に用いられているサーボ弁は幾種類かのものが開発されており応答性 は改善されているが、サーボ弁自体が複雑な構造を持ち特性が把握しにくい, 高価であるなどの欠点を持つ、サーボ弁を用いた研究は、フィードバック系を 用いた WONG ら¹⁶⁾や適応制御を用いた竹下ら¹⁷⁾,外乱オブザーバを用いた則次ら ¹⁸や, サーボ弁と人工筋アクチュエータを開発した青木ら¹⁹がある. YANG²⁰ら, VAN VARSEVELD²¹⁾ら、鈴木ら²²⁾はサーボ弁より構造が簡単な電磁弁を用いてサー ボシステムを構築しその有効性を示している.しかし,電磁弁を限界開閉周波 数以内で動作させる従来の制御方式では、弁の開閉に起因する圧力変動が必ず 発生するという大きな欠点があった. WACHOWIAK ら ²³⁾は複数の電磁弁を使用する ことによってその問題を解決しているが、部品数の増加によるコスト増や制御 の複雑化は免れない、本章では、電磁弁へ限界周波数を超えた適度な周期で、 開信号と閉信号を入力することにより、弁が完全に開いている状態と完全に閉 じている状態の中間状態、すなわち電磁弁を浮動させてこの問題を解決するこ とを提案する. 弁の浮動状態では必要な通過流量に応じた位置で弁が弁座から 浮動静止するため等価的なサーボ弁としての機能を持つが、従来この様な制御

方式は確立されていなかった.本章では,圧力や流量制御,および空気圧シリ ンダの位置決め制御において浮動状態が可能となる条件およびこれに適した制 御方式などを明らかにする.

サーボ弁を用いた場合制御系の次数が高くなりサーボ弁自体および空気圧の シリンダの摩擦や特性の非線形などの影響を強く受け易い.このため橋本ら²⁴⁾, 早川ら²⁵⁾, 栗田ら²⁶⁾のように制御理論を導入し非線形摩擦に対応するものや, 前田ら ²⁷⁾のようにディザを使用するなどの方法がある.いずれにしても制御系 は機器特性の数学モデルを組み込んで設計されるが,従来から空気圧シリンダ の数学モデルはシールが滑っている状態(摺動状態)に対してのみ考えられて いる、一般的なシールを用いた空気圧シリンダによる位置決めの場合、その行 程においてシールがシリンダ内部を滑っている状態と滑らずシリンダの内壁に 固着し弾性変形している状態がある. 荒木ら²⁸⁾がシールの摩擦がシリンダに与 える影響は少ないとしているが理論的な裏づけがされておらず、従来の空気圧 シリンダによる位置決めの研究の中で、シールに起因する特性を積極的に用い たものは皆無である.本章では、シールの粘弾性特性をモデル化し、位置決め 制御に利用し精度改善が行えることを示す. 非摺動状態と従来の摺動状態を考 慮した制御を効果的に組み合わせて行うことができれば、空気圧シリンダの欠 点であったシールとシリンダ間の静止摩擦力に起因する位置決めの困難さを回 避することができる.

第3章では光流体サーボシステム開発のキーデバイスとなる光流体変換器の 最適設計を可能とするため特性解析を示す.本論文では光信号により発生する 熱で噴流境界層の変化を発生させる動作原理を用いた光流体変換器を提案する. この光流体変換器は、フルイディクスである層流比例増幅器 LPA の供給ノズル 側壁に端面に光吸収体を塗布した光ファイバーを埋め込んだ構造をしている. 機械的可動部を持たず、電気信号を介在させる必要がないので、電磁気、静電 気、放射能、温度、衝撃などの影響を受けない、耐環境性、安全性に優れメン テナンスフリーで長寿命である.しかし、この光流体変換器は光吸収体の温度 上昇に対する供給噴流の温度分布の変化とそれによる速度分布の変化が解明さ れておらず、光強度と出力圧力差が理論的に求まらなかった.本章では光吸収

体の温度上昇に対する供給噴流の温度分布解析モデルと速度分布解析モデルを 提案する.また光流体変換素子の拡大モデルを製作し,光吸収体の温度上昇に 対する供給噴流の温度分布特性,速度分布特性さらに変換特性を実験により解 明する.そして,実験結果と比較することにより解析モデルの妥当性について 検討する.

第4章では、光流体サーボシステムの実用化を目的とし、光流体変換器を用 いて光信号を流体信号に変換し、空気圧式ロボットアームを駆動する「光制御 サーボシステム」の開発を行う.光流体変換器からの出力は,圧力,流量とも に微少であるために、直接空気圧アクチュエータを駆動することは不可能であ る光流体変換器からの出力を空気圧アクチュエータを駆動させることが可能と なる圧力、流量まで増幅するための増幅器として本章ではまずノズルフラッパ 機構を有する高感度膜型流体増幅器を提案する.この結果、光により直接空気 Fアクチュエータを駆動する空気圧制御システムが実現したことを示す.しか し、 膜型流体増幅器での増幅率が非常に大きく出力が不安定になる傾向がある. また、ノズルフラッパ機構を有するため、信号伝達遅れが大きくなる点や、出 力圧力が十分高くないためにアクチュエータの摩擦力の影響を受けやすい等の 問題点が発生した、そこで制御性能向上のため光流体変換器に駆動される流体 アクチュエータ系の特性を解明し、光流体システムの実用化を図るためロバス トな制御系の導入をおこなう、また膜型流体増幅器の代りにより実用的なエア サーボ弁を圧力増幅器として使用し、光流体変換器と組み合わせた光流体サー ボシステムを開発しその制御性能について示す.

 $\mathbf{5}$

記号

A	: シリンダの受圧断面積[m²]
Ai	:電磁弁の有効断面積[m²]
Ao	:オリフィスの有効断面積[m²]
b	: 流路幅[m]
с	:粘性減衰係数[Ns/m]
Cd	:流量係数
F	:最大静止摩擦力[N]
k	: ばね定数[N/m]
N_R	: レイノルズ数
N_R '	: 修正レイノルズ数
Р	: 圧力[Pa]
\Pr	: プラントル数
Q	:体積流量[m³/s]
Q_m	: 質量流量[kg/s]
R	: ガス定数[J/(kg・K)]
T	: 時定数[s]
Tc	: サンプリング周期[s]
u	: 流速[m/s]
X	: ロッド位置[m]
ż	: ロッド速度[m/s]
X	: 流路長さ[m]
ν	:動粘性係数[m²/s]
κ	: 比熱比
ρ	:密度[kg/m³]
σ	:アスペクト比

第2章 流体サーボシステムの開発

2.1 はじめに

流体制御システムは一般に、空気、水、鉱油などを動作媒体としたアクチュ エータ駆動装置、およびこれに必要となる圧力、流量などの制御機器を示す. 中でも空気圧を用いる場合、空気の持つ柔軟性を利用してオープンループ制御 をおこなう場合が多かった、すなわち、定められた仕様に合致した設計にして おき、現場で圧力や流量などを流路絞りにより調整して必要な性能を得ていた. しかし、近年、作業時間の短縮、作業内容変更の容易さ、省エネルギ化のため、 空気圧でもフィードバック制御を実施することが増えてきた、これらに対する 研究も盛んで、サーボ方式による空気圧シリンダの位置制御に関して、フィー ドバック系を用いた WONG ら¹⁶⁾や適応制御を用いた竹下ら¹⁷⁾,外乱オブザーバを 用いた則次ら¹⁸⁾や,サーボ弁と人工筋アクチュエータを開発した青木ら¹⁹⁾がサ ーボ弁を用いた位置制御に関する研究を行っている. 電磁弁を用いた疑似サー ボシステムとして、複数個の電磁弁を使用した WACHOWIAK ら²³⁾の研究やパルス 幅変調方式を用いて空気圧サーボ系の応答性を改善した YANG ら²⁰, VAN VARSEVELD ら²¹⁾, 超音波 PWM バルブを用いた鈴木ら²²⁾, ラビリンスシールと高 速電磁弁の導入による高精度位置制御を行った大司ら²⁹⁾が研究を行っている. 空気圧シリンダのシールによる非線形摩擦に対して、非線形 PID 制御系を用い た橋本ら²⁴⁾や、ディザの導入による非線形摩擦への有効性を確認した前田ら²⁷⁾、 スライディングモード制御を導入した早川ら²⁵⁾, 適応型 I-PD 制御を用いた橋本 ら²⁴⁾栗田ら²⁶⁾が,高度な制御理論を導入して制御性能の向上を図っている.

流量や圧力に関しても精度向上を目的としてサーボ方式が取り入れられ,サ ーボ弁を使った制御に関しファジィ推論を用いた NGUYEN³⁰⁾ら,非対称電空サー ボ弁を使った荒木³¹⁾ら,外乱オブザーバを用いた則次ら¹⁸⁾の研究がある.その 他,サーボ弁以外を用いたものとして,積層圧電アクチュエータを利用した空 気圧オンオフ弁により圧力制御を行う山本ら³¹⁾の研究がある.

電磁弁は Fig. 2-1 に示すように主に入口ポートと出口ポートの 2 つを持つ 2 ポート弁と, 2 ポートに排気弁を加えた 3 ポート弁がよく用いられる, 2 ポート

 $\mathbf{7}$

弁は主に空気圧回路のオンオフ用に用いられ、3 ポート弁は空気圧回路への供給 および排気に用いられる. 図中ではこれらの弁が単動型空気圧シリンダの駆動 に用いられているときの様子を示している. また, サーボ弁にはノズルフラッ パ型・スプール型などがある, ノズルフラッパ型サーボ弁の構造を Fig. 2-2 に 示す. 動作原理はノズルとフラッパの隙間を調節することによりノズルからの 流量を制限しフラッパ背圧の圧力を調整するものである. スプール型の構造を Fig. 2-3 に示す. スプールが移動し各ポートとの隙間を調節することにより出力 ポートの圧力を調整する. Fig. 2-4 にサーボ弁の代表的な特性図を示す. 入力電 圧と出力空気圧が比例する領域がありその範囲を利用して電空比例弁として使 用する.

これらは現在多くの市販品があり利用の実績も多いが、制御機器とは電流を 使ってインターフェースされるため、工場などでの使途以外は大きさ、耐ノイ ズ性、耐環境性などの点で問題がある。例えば、人に密接に接触する医療機器、 福祉機器などではより安全なインターフェース法が期待されてきた。本論文は 安全な光によりアンターフェースする光流体制御システムを提案するものであ るが、これが実用化されたときは従来の電磁弁、サーボ弁に置換できる。した がって、本章ではまず、光流体サーボシステムが実用化されたときの有用性と 限界を確認する目的で、従来の電磁弁、サーボ弁を使って流体サーボシステム を構築しその性能を評価する。すなわち、従来の流体制御システムの研究で不 十分であった問題点について整備することを目的としている。









Fig. 2-2 Nozzle flapper servo valve



Fig. 2-3 Spool servo valve



Fig. 2-4 Characteristic of servo valve

2.2 流体サーボによる圧力制御

電磁弁は空気圧回路の基本要素である. 信頼性,大きさ,価格の点 で完成度が高く,将来にわたって空気圧機器の重要な機器であること は間違いない.電磁弁は可動部であるプランジャをフルストロークで 動作させて空気流れを断続する.電磁回路,機構部,流体回路などで 応答遅れやヒステリシスが生じるためストロークの大きな領域で高速, 高精度な応答をさせるのは案外困難である³²⁾³³⁾.

操作流量や出力圧力を連続的に操作できる比例制御弁では,流体が 通過する流路断面積を電気式に調節する原理が使われる.電磁弁でこ のような操作が可能であろうか.すなわちプランジャをストロークの 中間で,すなわちプランジャにより動かされる弁を必要な流路断面積 を与える位置で静止できたならば,電磁弁で流量や圧力の連続的な可 変操作が可能となる.ひとつの方策として励磁電流を比例制御弁と同 じく連続的に変えることが考えられる.しかし,電磁回路や機構部は 強いヒステリシスや遅れをもつため,本来オンオフ動作を前提して設 計された弁では,流体力と釣り合わせて静止できる可能性はあるけれ ど困難である.

一方,系が遅れをもつことを積極的に利用し,固有振動数よりも速い振動数で励磁したとき,励磁振幅が一定であってもプランジャは静止する.またこのとき増減するコイル電流のループは非常に速く回転するため,ヒステリシスの影響は相対的に小さくなる.本節ではこの方式で電磁弁に高速な駆動パルスを与えて弁をストロークの中間に浮動させ,流量や圧力の連続的な操作をおこなう方式を提案する.

従来,電磁弁をパルス変調駆動する疑似比例制御がおこなわれていた³⁴⁾³⁵⁾³⁶⁾.このとき弁は搬送周波数と同じ周期で振動するが,もし搬送周波数が高ければ,一部で弁は浮動状態になることも考えられる. しかし現在まで浮動状態となることを意図した例は皆無である.本研究は圧力制御を例として,電磁弁の浮動状態による制御とその特性を示す.また,従来,このような制御が困難であった理由を考察し,電

磁弁を使った実験結果により,弁が浮動状態にあることを確認している.さらに出力精度や外乱が与えられたときの安定性の面から有効性 を検討する.

2.2.1. 電磁弁の駆動



Fig. 2-5 Pneumatic regulator using solenoid valve

電磁弁の開閉により直接圧力を制御する空気圧レギュレータを Fig. 2-5に示す³⁷⁾.図中の出力(Output)が制御された圧力の空気取出口 で,種々の機器の空気源となる.空気圧レギュレータの構造的要素とな るのは1個の電磁弁である.空気室は弁の開閉に伴う変動を必要なレ ベル以下に低減させるもので,給気する機器内容積や配管容量により 代用することも可能である.圧力センサで検出された出力圧力が目標 値となるよう,バンバン制御,もしくはパルス変調などオンオフ制御 をする.電磁弁の開閉に起因する出力変動の低減には電磁弁の開閉周波 数を高くすればよいわけであるが,目標圧力前後における切換圧力の 幅(しきい値)を単純に狭くするだけでは良好な結果は得られない 37)38)

Fig. 2-6は目標圧力を196kPaにしてバンバン制御をおこなったときの 出力圧力波形の例を示している. 電磁弁の切換圧力は弁開放時が 196kPa, 閉鎖時は198kPaである. 弁開放により出力圧力は上昇し, 閉 鎖により下降する. 弁の開閉動作には遅れを伴うため, 実際の圧力の 下限および上限はしきい値よりずっと大きな幅をもち, この例では圧 力変動率(リップル率)は目標値前後5%程度となっている. 使用し た電磁弁の開閉可能最短周期は約10msである.開閉の周期に十分余裕 があるように見えるが, 弁の開放時間, 閉鎖時間はそれぞれ出力流量 により異なり, この条件では開放時間は電磁弁の能力のほぼ限界に近 い. 図の一部に振幅が小さな部分があるが, 圧力に本質的に含まれる ノイズにより制御系が誤動作したためである³⁹⁾. 弁開閉のしきい値を 狭くし電磁弁の開閉周期を短くするほど相対的にノイズの影響が大き くなるため, 出力圧力は乱れた応答となり変動はこれ以上改善されな い. すなわち, バンバン制御では電磁弁の開閉可能な周期を越えて弁 を浮動状態にすることは困難である.



Fig. 2-6 Irregular pressure wave form in the Bang-Bang control

電磁弁が開閉可能な周期を超えた適度なパルス間隔で,開信号と閉 信号を印加することにより,弁ストロークの中間状態,すなわち,弁 の浮動状態で流量を制御することを試みる.以下,このような制御方 式を電磁弁浮動制御と呼ぶ.電磁弁浮動制御では,一種の連続比例制 御弁のように弁位置の連続的な変化によりおこなわれる.その結果,弁 の動作に起因する圧力変動をなくし目標圧力との誤差を減少すること ができる.

電磁弁への入力は、オンオフの2値信号であるが、弁を浮動させた まま連続制御するには、アナログ制御手法が必要になる.そのためパ ルス変調を利用して擬似的なアナログ制御をおこなう.本研究では制 御則により与えられたアナログ制御入力u(k)により、開時間To(k)と閉 時間Tc(k)を次式のように操作している.

$$To(k) = \frac{u(k)}{100}TL$$

$$Tc(k) = TL - To(k)$$
(2-1)

ただし T_L < To(k)では Tc = 0とする.ここで, T_Lは適当な定数である.この開閉則は u(k)によりデューティ比が変わる一種の P W M (パルス幅変調)方式であり,サンプリング周期 To(k)+Tc(k)および電磁弁の開閉 周期は T_Lにより決まる一定値となる.T_Lにより適当な開閉周期を与え, 電磁弁が浮動状態となるよう調整する.

出力圧力にはノイズが含まれるため、これを直接用いて u(k)を与え たのでは所定の動作が得られない.ノイズの影響を避けるため過去の 信号を伴用して積分動作を実行する必要がある.本研究では P I (比 例・積分)動作制御と一種の積分動作である適応制御を行っている.

P I 動作は、時点kにおける目標値r(k)とレギュレータ出力p(k)との 誤差 e(k)を

e(k) = r(k) - p(k) (2-2)

と定義し、制御入力u(k)は、比例ゲインKp、積分ゲインKi、サンプリング周期Tsを用いて次式のように与える.

$$u(k) = K_p \left[e(k) + K_i T_s \sum_{i=0}^{k} e(i) \right]$$
(2-3)

本節ではさらに供給圧力や流量変化など外乱に対する安定性を確保 するため、外乱オブザーバ⁴⁰⁾⁴¹⁾を付加した場合もおこなった.また演 算が多くなるためこれによる無駄時間を一サンプル遅れとし、スミス 補償器を組込んでいる.この時のブロック線図をFig.2-7に示す.



Fig. 2-7 Block diagram of the control system including disturbance observer



Fig. 2 - 8 Model reference adaptive control system

特性変動が大きい場合には制御対象の特性変動に応じて制御系の特性 をオンライン的に自動調整し、制御系としての性能を常に良好に保つ ような制御方式の導入が必要となる.このような機能を備えた制御系 が適応制御系(Fig.2-8)である.モデル規範形適応制御には直接法と間 接法の2種類ある.両者の違いは、直接法は制御則内の可変パラメータ が規範モデル・制御対象間の出力誤差を用いて直接調整されるのに対 し間接法は制御対象の未知パラメータが逐次推定され、その結果を用 いて所要の制御入力が適応的に合成される.本節では間接法を用いて いる.以下にその設計法を示す⁴²⁾.

制御の対象として次式で記述されるような1入力1出力の離散時間 システムを考える.

$$A(z^{-1})y(k) = z^{-d}B(z^{-1})u(k)$$
(2-4)

ただし,

$$A(z^{-1}) = 1 + \sum_{i=1}^{n} a_i z^{-i}, \qquad B(z^{-1}) = \sum_{i=0}^{m} b_i z^{-i}$$
(2-5)

z⁻¹:時間遅れ演算子 (z⁻¹y(k) = y(k − 1))

ここに, y(k), u(k)は時点 kにおける制御対象の出力,入力であり,多項式 $A(z^{-1})$, $B(z^{-1})$ は互いに既約で,その係数 a_i , b_i は未知の定数とする(ただし, $b_0 > 0$).

設計に際し式(2-4)の表現をそのままの形で用いることはできず,これ を非最小表現に改める必要がある.

まず,フルビッツ多項式

$$K(z^{-1}) = 1 + \sum_{i=1}^{n} k_i z^{-i}$$

$$F(z^{-1}) = 1 + \sum_{i=1}^{v} f_i z^{-i}$$

$$v = m + d - 1$$
(2-6)

を導入し, 信号 ζ_{ui}(k), ζ_{yi}(k)を

$$\zeta_{ui}(k) = F^{-1}(z^{-1})u(k-i-d)$$

$$\zeta_{yi}(k) = F^{-1}(z^{-1})y(k-i+1-d)$$
(2-7)

と定義すると、式(2-4)は次のように表すことができる.

$$K(z^{-1})y(k) = F(z^{-1}) \left[b_0 u(k-d) + \sum_{i=1}^{\nu} \alpha_{ui} \zeta_{ui}(k) + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{yi} \zeta_{yi}(k) \right]$$
(2-8)

上式は式 (2-4)の非最小表現であり, b₀, α_{ui}, α_{yi}は制御対象の未知パラ メータである.

多項式 $K(z^{-1})$, $F(z^{-1})$ は, $F(z^{-1})/K(z^{-1})$ が強正実となるように選ばなけれ ばならない.本研究では簡単のため $K(z^{-1}) = F(z^{-1})$ とし,制御対象出力 y(k)に観測ノイズが含まれるので, $F(z^{-1})$ の係数 f_i を適当に選ぶことにより $F(z^{-1})$ に雑音除去の役割を持たせている.式(2-4)のプラントに対応して, 次の規範モデルを考える.

$$A_{M}(z^{-1})y_{M}(k) = z^{-d}B_{M}(z^{-1})r(k)$$
(2-9)
ただし,

$$A_{M}(z^{-1}) = 1 + \sum_{i=1}^{w} a_{Mi} z^{-i}, \quad B_{M}(z^{-1}) = \sum_{i=0}^{v} b_{Mi} z^{-i}$$
(2-10)

ここに、 $y_M(k)$ は規範モデルの出力、r(k)は基準入力(又は指令入力)である.また、多項式 $A_M(z^{-1})$ 、 $B_M(z^{-1})$ の係数 a_{Mi} 、 b_{Mi} は規範モデルが有界な任意のr(k)に対して安定で望ましい応答を呈するようにあらかじめ決められる定数である ($A_M(z^{-1})$ は漸近安定多項式、すなわちフルビッツ多項式として選ばれるので、有界なr(k)に対しては $y_M(k)$ も有界となる).

制御対象の伝達関数は

$$G(z^{-1}) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} z^{-1}$$
(2-11)

とするので, m=1, n=2となる.

次に, 式(2-8)の非最小表現をつぎの形で表すことにする.

$$y(k) = \alpha^{T} \zeta(k)$$
(2-12)
ただし、

$$\begin{aligned} \zeta(k) &= \left[u(k-d), \zeta_{ui}(k), \cdots, \zeta_{uv}(k), \zeta_{yi}(k), \cdots, \zeta_{yn}(k) \right]^T \\ \alpha &= \left[b_0, \alpha_{u1}, \cdots, \alpha_{uv}, \alpha_{y1}, \cdots, \alpha_{yn} \right]^T \end{aligned}$$
(2-13)

ここで, (*n*+*v*+1)次元ベクトルαは制御対象の未知パラメータである.未 知パラメータを同定するために,次のような同定モデルを考える.

$$\hat{y}(k) = \hat{\alpha}^{T}(k)\xi(k) \qquad (2-14)$$

ここで, ŷ(k)は同定モデルの出力, â(k)は未知パラメータαに対応した可 変パラメータである.上式は式(2-13)の関係に注目すると,次のように 書き直すことができる.

$$u(k) = \frac{y_M(k+d) - \sum_{i=2}^{p} \hat{\alpha}_i(k) \xi_i(k+d)}{\hat{\alpha}_1(k)}$$
(2-15)

p = n + v + 1

ここで, 同定誤差 ε(k)を

 $\varepsilon(k) = \hat{y}(k) - y(k) \tag{2-16}$

と定義し、可変パラメータ â(k) が調整則

$$\hat{\alpha}(k) = \hat{\alpha}(k-1) - \Gamma \zeta(k) \varepsilon(k)$$
(2-17)

 $\Gamma = \Gamma^T > 0$

により調整されるならば、 $k \rightarrow \infty \tilde{\epsilon}(k) \rightarrow 0$ とさせることができる.

しかし,同定誤差 ε(k)が式 (2-16)の形では調整則が実行できない.そ こで,以下のように ε(k)を変形して用いる.まず,式(2-14)に式(2-17) を用いると

$$\hat{y}(k) = \hat{\alpha}(k-1)\zeta(k) - \zeta^{T}(k)\Gamma\zeta(k)\varepsilon(k)$$
(2-18)

となる.上式を式 (2-16) に代入し, $\epsilon(k)$ について解くと

$$\varepsilon(k) = \frac{1}{1 + \zeta^T(k)\Gamma\zeta(k)} \Big[\hat{\alpha}^T(k-1)\zeta(k) - y(k) \Big]$$
(2-19)

となる.このように変形することにより調整則が実行可能となる.

2.2.2 電磁弁を用いた圧力制御

2種の直動型電磁弁を使って浮動状態とした時の状態比較をおこ

なった.100Hzまでの比較的高速応答ができる断面積3mm²の2ポー ト電磁弁(Valve A)と、25Hzまでの通常の応答速度をもつ断面積 10mm²の市販の3ポート弁を2ポート弁として用いたもの(Valve B)であ る. 定常状態でいずれも弁を浮動状態とするため弁の最高開閉周波数 が200Hzとなるよう、弁の最短開閉周期を与えるTLは5msとした.

定常流量時における出力精度および弁位置はFig.2-9の装置により計 測した.空気室容量は500cm³,750cm³,1000cm³とした.出力 圧力は半導体圧力センサにより検出する.出力側は流出オリフィスに より種々の出力流量を設定している.弁の変位はプランジャに部材を 接着しコイル側に露出させ,エンコーダで直接計測している.部材は 軽く弁の動作に影響をあたえない.この改造により供給側から大気側 に空気漏れが生じるが量は僅少である.

供給圧力や流量が急激に変わる場合の応答特性はFig.2-10の装置により調べた.供給を高圧,低圧の2系統とし,弁(電磁弁)により瞬時に切換える.空気室に別途流出オリフィスIIを接続し接続した弁(電磁弁) で急激に開閉することにより出力流量をステップ状に変化させた.それ ぞれの場合の出力圧力の応答波形と偏差を記録した.



Fig. 2-9 Scheme of experimental apparatus for measurement of valve displacement



Fig. 2-10 Scheme of experimental apparatus

まず,従来のバンバン制御と電磁弁浮動制御の,定常流量時における圧力波形の比較をFig.2-11に示す.空気室容積は500cm³,流出オリフィス径0.6mmの例で示す.ここでは電磁弁浮動制御の代表としてPI動作による例で示している.

バンバン制御による結果をFig. 2-11(A)に示す.電磁弁はValve Aを 使って圧力変動が最も小さくなるしきい値により制御している.なお、 Valve Bは応答が遅いため、バンバン制御により圧力を調整すること はできなかった.

Valve Aによる浮動制御方式の結果を同図の(b)に、Valve Bによる 結果を(c)にそれぞれ示す.ともに圧力変動が発生せず、出力精度が飛 躍的に改善されることがわかる.TLは両弁とも同一としているため弁 開閉周期は同じである.そのため応答の遅い電磁弁の方が弁が動きに くいため、圧力変動の面で良好な結果が得られている.価格的に有利 な応答の遅い弁が使える点で注目に値する.







(c) Floating control with PI action (Valve B) Fig. 2-11 Comparison of pressure fluctuation

Valve Aをバンバン制御したときの弁変位を調べた結果と,弁変位 に対応する出力圧力をFig.2-12に示す. Valve Aの全ストロークはほ ぼ1mmである.弁変位の波形では弁ストロークの両端で,衝撃による 波形の行き過ぎが認められるが全ストロークを動いている.この移動 に約6msかかる.このとき弁の動きに対応して圧力変動が発生している. つぎに同じ弁を浮動制御したときの弁の動きと出力圧力をFig.2-13 に示す.弁は全閉状態よりわずかに浮いた状態で制御されており,弁 の動きはほとんどないことがわかる.



(b) Pressure Fig. 2-12 Displacement of valve and corresponding wave form with Bang.Bang control (Valve A)



Fig. 2-13 Displacement of valve and corresponding wave form with floating control (Valve A)

流出オリフィス径を変え出力流量を変化させたときの測定された電磁弁の浮動量と計算結果とを比較する. 弁座オリフィス内径を 2r, 弁座からの弁変位, すなわち浮動量を h とし,浮動時の電磁弁の有効 断面積 A_i は $2\pi rh$ と仮定し, 比熱比 κ , ガス定数 $R[J/(kg\cdot K)]$, 供給空気の 平均温度 $\theta_s[K]$, 流出側オリフィス有効断面積 $A_o[m^2]$, 容量内平均温度 $\theta[K]$, 電磁弁への供給圧力Ps=550(KPa·abs), 容器圧力P=300(KPa·abs) とすると, 質量流量 $Q_m[kg/s]$ は下式より求まる.



$$Q_m = A_i P_s \sqrt{\frac{2}{R\theta_s} \cdot \frac{\kappa}{\kappa - 1} \left[\left(\frac{P}{P_s} \right)^{\frac{2}{\kappa}} - \left(\frac{P}{P_s} \right)^{\frac{\kappa + 1}{\kappa}} \right]}$$
(2-20)

 $P/Ps \ge 0.528$ (絞り部で閉塞しない) これが流出オリフィスを通過する質量流量 Q_{mo} [kg/s]

$$Q_{mo} = A_o P \sqrt{\frac{\kappa}{R\theta} \cdot \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa-1}}}$$
(2-21)

Pa/P<0.528(絞り部で閉塞する)

に等しいことより浮動量 hが求められる.

弁位置は細かく振動しているため浮動量を最小二乗法で近似し、上 式で求めた浮動量と比較した結果をFig.2-15に示す. 流出オリフィス 径は0.6, 0.8, 1.0mmの3種により実験値と計算値を比較した. このと きの流量はそれぞれ, 0.88, 1.18, 1.47Nm³/s となる. 実験により求 められた浮動量はほぼ計算値と一致している.



Fig. 2-15 Floating displacement of valve

制御中に供給圧力と流出流量を急激に変化させた時の出力圧力の応答精度を示す.本節ではすべて電磁弁Valve Aを使用している.試験手順はつぎのようである.

供給圧力を高圧側とし、流出流量変動用弁(Valve C)を閉じた状態で、制御を開始する.

② 出力圧力が一定となった後,供給圧力を瞬時に低圧側へ切換える.

約1秒後に供給圧力を再び高圧側へ戻す.

④約1秒後に流出流量増加用の弁を開き瞬時に流出流量を増大させる。
 ⑤約1秒後に再び流出流量増加用の弁を閉じる。

Fig. 2-16に上述の実験手順に従った,各制御方式による結果を示す. バンバン制御による結果を(a)に示す.供給圧力の変化に対して大き な影響を受けている.供給圧力が低くなると弁の開閉に起因する圧力 変動の幅が減少している.これは供給圧力と負荷容量内圧力の差が小 さくなることにより,電磁弁の無駄時間における圧力変化が小さくな るためである.このように従来のバンバン制御では,出力圧力が供給 圧力の変化に影響されやすいという欠点がある.一方,流出流量の変 動に対しては,流出流量変化用の弁を開いた直後に一瞬乱れが生じる があまり影響は大きくない.これはバンバン制御は必要な演算時間が 短いためサンプリング周期を23μsと非常に短くできているためと考え られる.

つぎに、 P I 動作により浮動制御した結果を同図(b)に示す. 供給圧

カの変化があっても目標圧力へ整定する.しかし,直後には大きな誤差が発生している.流出流量の変動に対しては,大きな誤差はない. 出力圧力が一定になるまでしばらく時間がかかり1秒間では整定していない.供給圧力や負荷条件がともに変化する場合は,適当なゲインを決定することが非常に困難であった.このようにPI動作はゲイン係数 *Kp*, *Ki* の設定を条件毎に厳密におこなう必要があり実用性の面で難点があった.

外乱オブザーバを付加した P I 動作(同図(c))では,変化直後の誤差の大きさに大差はない.しかし,圧力が整定するまでの時間ははるかに改善され,外乱に対する効果が認められる.

適応制御による浮動制御は制御系の未知パラメータを逐次同定し電磁弁の開閉タイミングを調整するものである.実験結果(同図(d))では, 変化直後の誤差を小さく抑制でき,変化直後の整定もほかと比較して 良好であることが示された.制御則に必要な条件は理論で示された様 に制御系の次数だけよく,設計パラメータである式(2-5)のΓは広い範 囲で安定で良好な出力精度が得られた.この点においても適応制御は より実用的であった



(a) Bang Bang control



(b) Floating control (PI action)



(C) Floating control (PI action with disturbance observer)



(d) Floating control (MRAC)Fig. 2-16 Comparison of control method

比例制御弁あるいはサーボ弁には圧力型および流量型がある.後者は実際に操作され るのは流路面積であり,流量が直接指定できる訳ではない.圧力サーボ系を電磁弁で構 成するとき,従来は弁の安定動作の範囲でパルス幅変調 PWM などのオンオフ制御する方 式が用いられていた³²⁰.オンオフ制御では弁開閉による変動を生じる.しかし,この変 動は出力されている流量により変化するためこの変動により逆に出力流量を知り,必要 な流量となるよう弁開閉を操作すれば,制御流量を直接指示できる流量サーボ系が構成 できる.本節では出力される流量を圧力変動により検出するため等温化圧力容器⁴²⁰を電 磁弁出力側の負荷容器として用いた流量直接制御サーボ系について述べる.

2.3.1 等温化圧力容器を用いた流量測定

本節で使用した実験装置の概要を Fig. 2-17 に示す.実験装置の基本要素は1 個の電 磁弁と等温化圧力容器である.容器内に半導体圧力センサを設置している.容器からの 流出側から機器へ所定の流量を供給する.本節では、この流量を前節同様オリフィスを 流れる流量で模擬する.電磁弁開閉により容器内に発生する圧力変動により流量を計測 するが、この様な動的な流量を計測するために等温化圧力容器を利用している、これは 香川によって開発されたもので熱伝導率に優れ、また接触面積の広くとれる金属線を圧 力変化後の空気に触れさせ熱伝導を促進させるものである.構造は内径 6.0cm のアクリ ルパイプ内にスチールウールを充填したものとなっている. 電磁弁は25Hz までの通常 の応答速度をもつ断面積10mm²の市販の3ポート弁を2ポート弁として用い、オリフィ スの通過後圧力は大気圧とした. 一般に動的な流量を測定するのは困難である. 香川ら は等温化圧力容器を用いて空気の状態変化を等温とし、既知の容積の容器内の圧力変化 から通過流量を算出する方法を提案42し、その有効性を示している.まず、本節で提案 した流量測定方法の有効性を確認するために, Fig. 2-18 に示すように出力口に積算流量 計を設置し、圧力変動より求められた流量と積算流量計によって求められた測定結果を Table2-1 に示す. 積算流量計は、本装置の目的である大流量を測定できないため低流量 での比較となったが両者はよく一致し妥当性が示された.



Fig. 2-18 Scheme of experimental apparatus for calibration

	Flowmeter	Measured from isothermal chamber
Flow rate(cm ³ /s)	345.7	350.1

Table 2-1 Comparison of flow control

2.3.2 圧力変動を用いた流量制御

電磁弁の制御方式はバンバン制御を使用している.供給圧力は 490kPa,電磁弁は一般の3ポート弁を使用している.このため,出力は弁が出力側に切換わった時のみに行われる.連続的に流量を制御する場合2ポート弁を供給から容器への開閉のみに用い,出力側は絶えず流量が出力される方式にするほうが原理的には好ましいが,より正確に流量を測定するために,今回はこの様な構成とした.

電磁弁が出力側に切換わっているとき,電磁弁を通過する流量*Q_m* [kg/s]は,大気圧 力を*P_a* [Pa·abs],容器内圧力を*P* [Pa·abs],電磁弁の有効断面積を*A_a* [m2],負荷容量内 平均温度をθ [K]とすると,次式のよう表される.

$$\frac{P_a}{P} < 0.528 \quad (絞り部で閉塞する場合)$$

$$Q_m = A_o P \sqrt{\frac{\kappa}{R\theta} \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa-1}}} \quad (2-22)$$

 $\frac{P_a}{P} \ge 0.528$ (絞り部で閉塞しない場合)

$$Q_m = A_o P_{\sqrt{\frac{2}{R\theta} \frac{\kappa}{\kappa - 1} \left[\left(\frac{P_a}{P}\right)^{\frac{2}{\kappa}} - \left(\frac{P_a}{P}\right)^{\frac{\kappa+1}{\kappa}} \right]}$$
(2-23)

一方容器内圧力 P の変化は弁開時および弁閉時の流入・流出流量から等温変化より計算できる.したがって目標流量を増やす場合,式(2-22,23)より弁開時間を増し現在のものより容器内圧力 P を上げれば電磁弁を通過する流量を増加することができる.目標流量が与えられた場合,容器内圧力変化を測定し弁開時および弁閉時の圧力が計算により求められる必要な値となるよう弁開閉タイミングをリアルタイムに制御する.バンバン制御は Fig2-19 のように,目標圧力 P_aに対してある一定のしきい値を設定し,しきい値の上端 P_a,下端 P_iで電磁弁を開閉させる.バンバン制御による容器内圧力を Fig. 2-15

に示す. この図からわかるように、負荷容量内圧力は激しく振動している. この振動は 弁の開放と同時に発生し、弁の閉鎖と同時に減衰し始める. この振動の振幅や減衰の速 度は、負荷条件や設定リップル率、供給圧力、目標圧力などに依存する. Fig. 2-20(b) は目標圧力付近を拡大した図であるが、目標圧力付近での振動の振幅が、上側のしきい 値と下側のしきい値との幅よりも大きい場合は、Fig. 2-21 のように電磁弁への入力は容 器内圧力が目標圧力付近まで下がった時点で非常に短い周期で開信号と閉信号を繰り 返すこととなる. 電磁弁には無駄時間が存在するので、このような信号を入力しても希 望通りの開閉動作は実現できない. つまり短い周期で開信号と閉信号を繰り返しても弁 は動かないので、結果的に弁の動作が遅れる. その間に容器内圧力は目標圧力から離れ てしまい、容器内圧力の変動幅はかえって大きくなる³²⁾. この条件は流量と容器容積に も依存し、本実験装置における安定して流量制御を行なえる電磁弁動作限界周波数は 10Hz であり以後これ以下の周波数となるようにして実験した. 目標流量を 5×10⁻⁴m³/s とした場合の圧力波形を Fig. 2-22 に示す. 圧力上限下限値の変動がなく安定して空気 の供給が行われている. 圧力波形から1サイクル当りの流量を計算した結果をFig. 2-23 に示す. 目標の流量が得られている.

Fig. 2-24 に電磁弁動作周波数 10Hz, 目標流量 14×10⁻⁴m³/s の容器内圧力波形を示す. 制御開始後約 1.5 秒で安定した動作となっている. 出力流量を計算した結果を Fig. 2-25 に示す. 流量が大きいため目標値に収束するまでに約 1.8 秒かかっている. 目標流量が 急激に変化する場合の実験結果を Fig. 2-26 に示す. 目標流量を制御開始 1.5 秒後に 5 ×10⁻⁴m³/s から 7.5×10⁻⁴m³/s に変化させた場合の結果である. 目標流量の変化に対応し て電磁弁開閉開始圧力の変化がおこり, Fig. 2-27 に示すように目標流量に速やかに移行 している.



Fig. 2-19 Image of ripple



Fig. 2-20(a) Oscillating pressure with Bang-Bang control







Fig. 2-21 Signal with low ripple percentage


Fig. 2-22 Pressure wave form of flow servo control



Fig. 2-23 Calculated flow rate form from pressure wave



Fig. 2-24 Pressure wave form of flow servo control



Fig. 2-25 Calculated flow rate form from pressure wave



Fig. 2-26 Pressure wave form of flow servo control



Fig. 2-27 Calculated flow rate form from pressure wave

- 2.4 流体サーボによる位置制御
- 2.4.1 電磁弁を浮動状態とさせて用いた空気圧位置制御

従来空気圧アクチュエータの位置制御はいわゆる「あて止め」, すなわちストローク端 やワークに直接衝突させて停止させる方式が用いられてきた. しかし, 衝撃の緩和や動 作の自由度を確保するため, 任意の場所への位置決めに関する関心が高くなってきた.

高精度・高応答な位置制御をおこなうには電空サーボシステムが構成される.そのた め高性能な電空制御弁が必要であり,サーボ弁を用いたアナログサーボシステムが一般 的に用いられる.しかし,サーボ弁は高価であり,複雑な構造を持ち特性の把握が困難 であるなどの問題がある.そこで,サーボ弁の代わりに第2節で用いた電磁弁浮動制御 方式を用いてシリンダを制御するサーボ系の有効性を検討した.



Fig. 2-28 Pneumatic servo system using solenoid valve

電磁弁の開閉により位置を制御する空気圧サーボ系をFig. 2-28に示す. 図中のシリン ダは内径50mm・ストローク200mmで, ロッド側を一定圧とし, ヘッド側の圧力をバンバ ン制御, もしくはパルス変調などオンオフ制御をすることにより調節しロッドの位置を 制御する. 25Hzまでの通常の応答速度をもつ断面積10mm²の市販の3ポート弁を2ポー ト弁として用いたものをシリンダヘッド側に吸気用と排気用に2つ設置し弁を絶えず浮 動させた状態として実験をおこなう. 電磁弁への入力は、オンオフの2値信号である.弁を浮動させたまま連続制御するには、第2節と同様のアナログ制御手法が必要になる.

本節におけるPI動作は時点*k*における目標位置*r*(*k*)とシリンダロッド位置*p*(*k*)との誤 差*e*(*k*)

$$e(k) = r(k) - p(k)$$
 (2-24)

を用い制御入力u(k)は、比例ゲインKp、積分ゲインKi、サンプリングタイムTsを用いて 次式のように表される.

$$u(k) = K_p \left[e(k) + K_i T_s \sum_{i=0}^{k} e(i) \right]$$
(2-25)

システムの状態変数 $\mathbf{x}(t)$ をロッドの位置 $\mathbf{x}(t)$,速度 $\dot{\mathbf{x}}(t)$,ヘッド側圧力 p(t)として、 状態変数ベクトルを $\mathbf{x}(t) = [\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), p(t)]^{T}$,電磁弁入力u(t)より状態方程式は

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{c}{M} & -\frac{A}{M} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{G}{T} \end{bmatrix} u(t)$$
(2-26)

となる. 零次ホルダで離散化した状態方程式を

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}\mathbf{u}(k) \tag{2-26}$$

とし, 1型のサーボ系を構成したとき偏差系

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_{e}(k+1) \\ u_{e}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \mathbf{b} \\ \mathbf{0} \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{e}(k) \\ u_{e}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}(k)$$
(2-27)

に関する評価式

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{e}(k) \\ u_{e}(k) \end{bmatrix}^{T} \mathbf{Q} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{e}(k) \\ u_{e}(k) \end{bmatrix} + rv^{2}(k) \right\}$$
(2-28)

を最小とする最適入力は

г

$$u_{e}(k+1) - v(k) = -\mathbf{f}_{0} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{e}(k) \\ u_{e}(k) \end{bmatrix}$$
(2-29)

となる.ただし, $x_e(k)$ および $u_e(k)$ は定常値からの偏差, \mathbf{f}_0 は, \mathbf{A} , **b**より決まる定数ベクトルである.

実験結果をFig.2-29に示す. 目標入力は正弦波で振幅37mm, 周期100mmである. バン

バン制御を使用したFig. 2-30(a)はオーバシュート量が大きく全般で振動している.浮動制御のFig. 2-30(b)では全般にわたりシリンダが目標に対して良好に追従している. このように浮動制御方式を使用することによりシリンダに対しより滑らかな制御を行う ことが可能となった.次に,従来のサーボ弁を使用した場合と比較する.サーボ弁を使 用したFig. 2-30(c)に示す結果に対して,電磁弁浮動制御は違いがほとんどなく従来の サーボ弁に比較し遜色ない結果をあげている.

目標入力に対する出力の誤差をFig. 2-31に示す. 誤差の絶対値は高価なアナログサー ボ弁と同等である. さらに電磁弁浮動方式の方がシリンダの移動方向が変わる時に発生 する誤差が少ない. この様に従来のサーボ弁を使用した場合よりも良好な結果が得られ た.

全ての実験を通して、応答初期のオーバシュートが発生している.そこで、最適制御 を導入することによって応答の改善を図る.その結果をFig.2-32に示す.目標値は 100mmのステップ波である.最適制御を用いることにより、オーバシュートは22.6mmか ら1.6mmへ93%減少し、収束時間は5.1sから0.2sへ96%減少した.

以上より,電磁弁浮動制御で最適制御を用いることにより比較的簡易に制御性能を向上 させることができた.



(a) Bang·Bang Control



(b) Floating control







Fig. 2-30 Comparison of error



(a) Positioning result using PI action





2.4.2 サーボ弁を用いた空気圧位置制御

(空気圧アクチュエータの粘弾性を考慮した制御)

空気圧シリンダなど空気圧アクチュエータの高精度位置決めは一般に困難とされている.理由は、アクチュエータ内部に空気封止のためゴム製シールが用いられており、 非常に大きな動作摩擦があるためである.しかし、このシールによりアクチュエータは 静止位置で粘弾性特性を持ち、この特性を応用すれば摺動時の摩擦と関係なく、高精度 な位置決めが実現できる可能性がある.

従来,空気圧シリンダの数学モデルはシールが滑っている状態(摺動状態)に対して のみ考えられている.一般的なシールを用いた空気圧シリンダによる位置決めの場合, その行程においてシールがシリンダ内部を滑っている状態とシリンダの内壁に固着し 弾性変形している状態が考えられる.今まで行われてきた空気圧シリンダによる位置決 めの研究の中で,シールに起因する特性を積極的に用いたものは全く見あたらない.シ ールの粘弾性特性に着目しその特性を明らかにし位置決め制御に利用する.従来の摺動 状態のみを考慮した制御と効果的に組合わせれば,シールとシリンダ間の静止摩擦力に 起因する位置決めの困難さを回避することができる.以上の観点から本節では,シール の摺動状態と非摺動状態をリアルタイムに判別する手法を明らかにし,これにより2つ の特性モデルを切換えて有効な制御を実行する.

従来,空気圧シリンダの特性モデル(摺動モデル)としてFig. 2-32のものが用いられる. このモデルはシール部で発生する粘性減衰係数c'により生じる粘性摩擦力とクーロン摩 擦力Fcを表したものとなっている.しかし,位置決め点近傍ではシールが粘着するた め粘弾性モデル(非摺動モデル)を考慮する必要がある.この場合,摺動モデルと大きく 異なる点は、シール弾性の影響が現れてくることと、粘性がシールの物理的性質に起因 するものであるから摺動時と特性値が全く異なることである¹⁵⁾.粘弾性モデルとして複 数のばねとダンパの組合わせが使われることもあるが、実用的なモデルとしては単純な ものほど有用であるため、Fig. 2-33に示すような1個のばねとダンパからなるKelvinモ デルで近似することにした.シール特性が持つヒステリシスによる動作点のずれおよび 不感帯を表すため、移動方向により向きの変わる一定な摩擦力F.を導入している.

43



Fig. 2-32 Conventional model of pneumatic cylinder



Fig. 2-33 Proposal model using Kelvin model

実験装置の概略をFig. 2-34に示す. この装置は試験空気圧シリンダと2つの3ポート サーボ弁より構成される.シリンダのロッド側の圧力は一定とし、ヘッド側室内圧力は 目標の圧力となるよう圧力サーボ系を構成している.シリンダ変位は、0.1µmの分解度 を持つ光学式測長器を使用し計測している.シール材としては従来から一般に使用され ているニトリルゴム使用したシリンダを用い、またシリンダ内径は40.0mm、ストローク 100.0mmである.



Fig. 2-34 Scheme of experimental setup

計測された摺動・非摺動モデルのばね定数kと粘性減衰係数cおよび最大静止摩擦力 F_c をTable. 2-2に示す.なお、 F_r の値と F_c の値の差は非常に小さかったので簡単のため F_r と F_c は同じ値を用いた.非摺動モデルではシールが粘着していることを確認しながら、圧力を目標値までランプ状に変化させたときのシリンダ変位より求めた.

	ばね定数 k (10 ⁵ N/m)	粘性減衰係数 <i>c</i> (kNs/m)	最大静止摩擦力 Fr, Fc (N)
非摺動時	7.34	632	0.894
摺動時		0.326	0.894

Table 2-2 Parameters of each model

両モデルより与えられる制御系の安定領域をPI動作により比例ゲイン K_p ,積分ゲイン K_p ,積分ゲイン K_i について求めた結果をFig. 2-35に示す.破線がラウスフルビッツの安定条件より求めた非摺動モデルによる安定限界であり領域の内部で安定となる. F_r , F_c は実験によると0.894Nと小さく,また安定領域の概要が簡単に求められることが望ましいため無視した.

一方, 摺動時は c の値が1/200程度と小さくこのため安定領域は破線に示すように極め て小さくなる.プロットは実験により求めた非摺動時の安定限界である.計算とは若干 の相違があるものの,モデルは安定限界の傾向を示すことができている.



Fig. 2-35 Stable region of PI action

次に状態フィードバック制御を実行したときの粘弾性が及ぼす効果を示す.状態変数 $\mathbf{E} \mathbf{x}(t) = [\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t), p(t)]^{\mathrm{T}}$, サーボ弁入力をu(t)として, 状態方程式は粘弾性モデルでは

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{c}{M} & -\frac{A}{M} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{G}{T} \end{bmatrix} u(t) - \operatorname{sgn}(v(t))F_{v}$$
(2-30)

摺動モデルでは

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{c'}{M} & -\frac{A}{M} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{G}{T} \end{bmatrix} u(t) - \operatorname{sgn}(v(t))F_{S}$$
(2-31)

となる.粘弾性の効果を見るため、摩擦力 F_r 、 F_c は余り大きくないとして無視し零次ホルダで離散化した状態方程式をそれぞれ

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}_{v}\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}_{v}u(k)$$

 $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}_{s}\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}_{s}u(k)$
とし、1型のサーボ系を構成したとき偏差系

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(k+1) \\ u_e(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(k) \\ u_e(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \mathbf{v}(k)$$
(2-32)

に関する評価式

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(k) \\ u_e(k) \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \mathbf{Q} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(k) \\ u_e(k) \end{bmatrix} + r v^2(k) \right\}$$
(2-33)

を最小とする最適サーボ入力は

$$u_{e}(k+1) = v(k) = -\mathbf{f}_{0} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{e}(k) \\ u_{e}(k) \end{bmatrix}$$
(2-34)

となる.ただし、 $\mathbf{x}_e(k)$ および $\mathbf{u}_e(k)$ は定常値からの偏差, \mathbf{f}_0 は, \mathbf{A}_v , \mathbf{b}_v あるいは \mathbf{A}_s , \mathbf{b}_s より決まる定数ベクトルである.

シールの摺動・非摺動状態を制御中にリアルタイムに判別する方法として、次の様に シリンダの移動速度による判別と、ニューラルネットによる判別の2種を採用しその有 効性を検討した.

a)移動速度による判別

シリンダの移動速度がしきい値以下の時に非摺動モデル,しきい値以上の時に摺動モ デルに切換えて制御する.しきい値は実験により適当な値を使用する.

> $v \le \alpha \rightarrow \text{Stick model}$ $v > \alpha \rightarrow \text{Slide model}$ ここで α :しきい値

b) ニューラルネットによる判別

ニューラルネットによりシールの摺動・非摺動状態を推定させ、これにより制御モデ ルを切替えた.使用アルゴリズムはバックプロパゲーション学習アルゴリズムを使用し た.ネットワークは1つの中間層を含む3層のネットワークで、入力層ニューロン数が 2、中間層が20、出力層が1として、目標値に対する誤差とシリンダのヘッド内圧力 を学習用データとしてニューロンの学習を行い、得られたニューラルネットを実験に使 用しその効果を確認する.



Fig. 2-36 Neural network model

目標を 20mm, 制御モデルを切換えることなく位置決めを行った場合の実験結果を Fig. 2-37, 38 に示す. 摺動モデルでは、移動開始後約4秒で目標位置に収束しているが 0.2mmの定常誤差が残っている.非摺動モデルの場合は、目標値に対し収束せず振動的と なってしまった.次に、速度によりモデルを切替えて制御をした場合の結果をFig. 2-39 に示す. 目標値前後で微小な振動が発生している. 速度情報のみでは, 摺動・非摺動状 態の判別が不可能であったためと考えられる、最後に、ニューラルネットにより摺動・ 非摺動状態を判別した結果を Fig. 2-40 示す. 応答に乱れがなくスムーズに切換えが行 われている. 目標値±2%以内に収束した場合を整定とし, 定常誤差を比較した結果を Fig. 2-41 に示す. 非摺動モデルのみを使用した場合は整定せず定常誤差を計測すること はできなかった. 摺動モデル単独で制御した場合, 定常誤差は48µmとなったがばらつ きが多く測定毎に値が 200μm から 40μm の範囲で変化する. 速度情報のみで判別した 場合、一定値に整定しないので誤差の最大値を記載した、ニューラルネットにより判別 した場合定常誤差は 0μm となり他と比較して良好な制御結果となった.次に立上り時 間として目標値に 90%に達するまでの時間を比較した結果を Fig. 2-42 に示す. 速度に よる判別した場合が最も短い時間であり静止状態から速やかにシリンダを動かすこと ができたと、最後に、整定するまでの時間を比較した結果を Fig. 2-43 に示す. 非摺動 モデルのみで制御した場合整定しなかったので記載していない.他の3つを比較すると ニューラルネットによる判別が最大で約80%の時間短縮結果となった.



Fig. 2-37 Optimal control using slide model



Fig. 2-38 Optimal control using stick model



Fig. 2-39 Optimal control using discrimination by velocity



Fig 2-40 Optimal control using neural network



Fig. 2-41 Steady state error



Fig. 2-42 Rising time



Fig. 2-43 Settling time

2.5 まとめ

本章では、流体サーボシステムを実現する上で障害となっているいくつかの 問題に対して、一般に普及している機器を用いてその解答となる研究を行った. 本章を要約すると以下のようになる.

- 電磁弁浮動制御方式を用いることにより,弁の開閉に伴う圧力変動を取り 除くことができた.また、従来のサーボ弁に遜色ない制御性能を得た.オ ンオフ制御を目的とした電磁弁を高速かつ高精度に圧力を制御できる高度 な目的をもつサーボ弁に置換できることを示した.
- 2) 電磁弁と等温化圧力容器とを共に使用することによって、従来実現できなかった質量流量を直接制御できる流量制御弁を実現した.流量変動は実験では最大で 8.5%であり良好に流量を制御することが確認できた.
- 3) 空気圧シリンダの高精度位置制御にはシールの摺動および非摺動の2つの モデルを切換えて制御をおこなうのが効果的である.これにはシールの摺 動状態,粘着状態の判別が必要となる.判別法としてニューラルネットを 使用することにより,定常誤差0.1µm以下に位置制御できた.従来困難で あった空気圧シリンダの高精度な位置制御が可能であることを示した.

第3章 光流体変換器の開発

3.1 はじめに

本章は光流体制御システムのキーデバイスとなる光流体変換器の開発につい て述べるものである.

従来の流体制御システムは、電気信号で、増幅器や電気・流体サーボ弁を介し てモータやシリンダ等のアクチュエータを制御する.しかし、放射能や電磁気 ノイズなどが存在する極限環境下では、媒体に電気信号を用いると正常に作動 しない恐れがある。一方、駆動部に電子回路を持つことなく、光により直接制 御される流体制御システムは、非常に過酷な環境に耐えられるものと考えられ る.このためには光流体変換を効率的に行う素子の開発が必要となる.本章で は、
層流比例増幅素子(LPA)を用いた光流体変換器とその出力をパワー増幅する フルイディクアンプから構成される光流体変換器を提案する.このフルイディ ク光流体制御は、光信号を直接流体信号に変換するものである。機械的駆動部 なしで、純流体的に光信号を直接流体信号に変換する原理は以下のようである. レーザー光による光エネルギは、光ファイバの端面に転写されたカーボンブ ラックにより熱エネルギに変換される.そして、その発生熱により、供給噴流 境界層の温度が変るため、流体粘度が変化し、それにより速度分布がノズル軸 に対して非対称になり供給噴流は偏向し出力圧力差が生じる.しかし従来,光 流体変換部において光吸収体の温度上昇に対する供給噴流の温度分布や速度分 布が解明されておらず光流体変換特性が理論的に計算できなかった. そのため 効率的な光流体変換を可能とする設計条件が不明であった.

LPA の流れ解析におけるこれまでの方法は,流体の運動方程式と熱伝導方程式 が互いに独立で温度・圧力・流速を個々に解く方法がとられており熱変化を含む 現象を正確に捉えることが出来ない.本章では,Simplified Marker And Cell method(SMAC法)を用いた温度・速度分布の数値解析モデルを提案する.そして, 光流体変換素子の拡大実験モデルを作成し光流体変換素子内噴流の温度・速度 分布を測定し,実験と比較することにより解析モデルの妥当性を明らかにする.

54

3.2 システム構成

3.2.1 層流比例增幅素子(LPA)

光流体変換器の基本要素となる層流比例増幅素子(LPA)の形状をFig. 3-1に示 す.LPAは供給ノズルよりでた2次元層流噴流が噴流の左右の微小な圧力差に より偏向する現象を用いて、圧力信号を増幅する能動素子である.LPAは対称 構造を持ち、2つの制御ノズルにより圧力差を入力し2つの出力ポートにより 圧力差を出力する差動形増幅素子である.一定の供給圧力による供給噴流に左 右側壁の制御ポートから圧力差を加えると、供給噴流はこの圧力差に比例して 偏向する.この偏向した噴流を2つの出力ポートによって受け、噴流の偏向に 比例した出力圧力差を発生する.供給噴流に層流噴流を用いるため、非常に小 さな圧力差を増幅することが可能であり、入力インピーダンス、S/N比がとも に十分高く、さらにパワー消費も小さい.また、多段結合、積層化が容易であ りこれによって最終的には非常に大きい圧力ゲインを得ることが可能である.

3.2.2 光流体変換器

本研究で試作した光流体変換器をFig.3-2に示す. この光流体変換器は、ス テンレス製でワイヤーカット放電加工機で製作した. 変換器1段目の変換素子 には、基本要素となる層流比例増幅素子(LPA)の制御ポートを削除し、代りに 直径0.5[mm]の光ファイバの端面に光吸収体としてカーボンブラックを塗布し たものを供給ノズル側壁の下流端に埋め込んである. 変換素子の出力は微弱で あるため、さらに2段のLPAで純流体的に増幅させている. 供給ノズル幅は1 段目及び2段目が0.38[mm]、3段目が0.76[mm]である. 光流体変換器の厚さは 0.5[mm]なので、アスペクト比は1段目及び2段目が1.32、3段目が0.64であ る.

光流体変換器の出力をさらにパワー増幅するために、3段LPAカスケード増幅器と4つ並列にしたLPAで構成される流体増幅器を用いている.3段LPAカ

55

スケード増幅器は、光流体変換器の3段目と同じ形状寸法のLPAを用いており、 1段目がノズル幅が0.76[mm]、アスペクト比が1.05のLPA1枚で、2段目、3 段目はそのLPAを2枚、3枚と積層した素子にし直列につないでいる。断面積 を徐々に大きくすることによって圧力、流量ともに増幅される。

流体増幅器は、CORNING社製の型番17240の比例形増幅素子を用いカスケード 増幅器の出力圧力および流量増幅をおこなう.



Fig. 3-1 Laminar proportional amplifier



Fig. 3-2 Opto-fluidic conversion device

3.3 光流体変換器の特性

3.3.1 数値流体解析法を用いた速度・温度分布解析モデル

光流体変換素子の光信号を流体信号に変換する際における,供給ノズルスロート部内の速度・温度分布解析モデルについて考察する.

光吸収体の温度上昇に対する供給噴流の温度分布や速度分布が解明されておらず,光 流体変換特性が理論的に計算できなかった.そこで,Simplified Marker And Cell (SMAC) 法を用いた温度・速度分布の数値解析モデルを提案する.



Fig. 3-3 Analytical model

数値解析を行うにあたって深さ方向を考慮に入れず 2 次元流として解析を行った. また,作動圧力が微圧であるので非圧縮流体として解析を行うものとする.壁面上の境 界条件は,流速は0,圧力は壁面付近の値を取るものとした.即ち, $p^{i,j} = p^{i-1,j}$ として, 壁面に接している格子の圧力を壁面内側の格子の圧力に代入した.壁面上の法線方向速 度 $_{u^{i,j}}$ は0とし,接線方向速度は壁面に接している格子の接線方向速度に-1をかけた値 $v^{i-1,j} = -v^{i,j}$ を壁面内側の格子に代入することにより,壁面上で速度が0となるようにし た.流入口では供給口流速を境界条件とした.



Fig. 3-4 Staggered grid on the wall

従来の SMAC 法は非圧縮流体を解析する際温度変化を考慮に入れた場合でも流体の粘 性の変化を考慮に入れず熱伝導と対流の問題にのみ適用している.本研究対象である光 流体変換素子は温度上昇による流体の粘性変化を利用して噴流の偏向を制御する方式 を採用している.そのため従来の解析法では、光流体変換素子の温度・速度分布の解析 には適用することができない.そこで、SMAC 法に温度変化による流体の粘性変化を導入 することによって、光流体変換素子内部の温度・速度分布解析をおこなう.

非圧縮流体の運動は非圧縮性ナビエストークス方程式によって求まる.外力が無視で きる場合,連続の式,非圧縮性ナビエストークス方程式,エネルギー方程式は

$$\begin{cases} \nabla \cdot u = 0 & (3-1a) \\ \frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \frac{1}{N_R} \Delta u & (3-1b) \\ \frac{\partial T}{\partial t} + (u \cdot \nabla)T = \frac{1}{N_R \cdot \Pr} \Delta T & (3-1c) \end{cases}$$

と記せる.(3-1b)の左辺第2項が非線形であること,速度については時間発展型になっているが圧力については時間発展型になっていないことから数値解法を困難にしている.速度を求める場合各時間ステップで連続の式(3-1a)を満足するように圧力を求める必要がある.非圧縮性ナビエストークス方程式を数値的に解く方法は

i) 圧力を消去する方法

ii) 圧力を独立に求める方法

- iii) 擬似的な圧縮性を導入する方法
- iv) 連続の式、ナビエストークス方程式を同時に連立させて解く方法

に大きく分類される.本章ではii)の圧力を独立に求める方法として SMAC 法により温度・速度分布を求めた.差分近似には前進差分を採用した.

時間積分にオイラー陽解法を用いることにより、時刻 $(n+1)\Delta t$ における仮の速度 \tilde{u} は 時刻 $n\Delta t$ における圧力 P^n と速度 u^n を用いて次式で求められる.

$$\widetilde{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{u}^n + \Delta t (-(\boldsymbol{u}^n \cdot \boldsymbol{\nabla}) \boldsymbol{u}^n - \operatorname{grad} \boldsymbol{P}^n + \frac{1}{N_R^n} \Delta \boldsymbol{u}^n)$$
(3-2)

ここで N_{R} " は時刻 $n\Delta t$ における温度T"により求められたレイノルズ数である.仮の速度 \tilde{u} はこのままでは連続の式を満足しないため、非回転速度場u'を用いて

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{\tilde{u}} + \boldsymbol{u}' \tag{3-3}$$

と書いたうえで、

div
$$u^{n+1} = 0$$
 (3-4)

となるように u'を決める.

u'は渦なしとしたため、スカラーポテンシャルφが存在して

$$\operatorname{grad} \varphi = \boldsymbol{u}' \tag{3-5}$$

と書ける. したがって式(3-4)は

$$\operatorname{div} \boldsymbol{u}^{n+1} = \operatorname{div}(\boldsymbol{\tilde{u}} + \operatorname{grad} \boldsymbol{\varphi}) = \operatorname{div} \boldsymbol{\tilde{u}}^n + \Delta \boldsymbol{\varphi}$$
(3-6)

となるが,式(3-4)に留意すると

$$\Delta \varphi = -div \, \tilde{u} \tag{3-7}$$

が得られる.これを解いてφを求め,式(3-5)からu'を求めれば式(3-3)を用いて新しい 時間ステップでのuが決まることになる.

次の時間ステップの圧力場 P"+1は現時刻での圧力 P"を用いて

$$\boldsymbol{P}^{n+1} = \boldsymbol{P}^n + \boldsymbol{P}^{\prime} \tag{3-8}$$

と書く. 式(3-2)の右辺の圧力項を *P*ⁿ⁺¹で置き換えたときの左辺が正しい速度場 *u*ⁿ⁺¹を与えると考慮して、

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t (-(u^n \cdot \nabla) u^n - \operatorname{grad} P^{n+1} + \frac{1}{N_R^n} \Delta u^n)$$

= $\tilde{u} - \Delta t \operatorname{grad} P'$ (3-9)

となる.式(3-9)の変形には式(3-2),(3-8)を用いた,uⁿ⁺¹は連続の式を満たすので式 (3-9)の発散をとって

$$0 = \operatorname{div} u^{n+1} = \operatorname{div} \widetilde{u} - \Delta t \triangle P'$$

より

$$\Delta \mathbf{P'} = \frac{1}{\Delta t} \operatorname{div} \tilde{\mathbf{u}} \tag{3-10}$$

が成り立つ. 式(3-7)と式(3-10)を比較すると

$$\Delta \varphi = -\Delta t \triangle P'$$

より,

$$P' = -\frac{\varphi}{\Delta t}$$

が得られる.したがって式(3-8)から正しい圧力場は

$$\boldsymbol{P}^{n+1} = \boldsymbol{P}^n - \frac{\varphi}{\Delta t} \tag{3-11}$$

となる.

実際の計算の手順はまず式(3-2)から仮の速度場*ũ*を決める.次にポテンシャル*P*に関 するポワソン方程式を SOR 法を用いて計算しており,各格子誤差の総和が10⁻¹²以下とな るまでループを繰り返しポテンシャル*P*を求める.ついで,式(3-5)から*u*'を求める. 新しい時刻での速度は式(3-3)から,また新しい時刻での圧力は式(3-11)から決まる. 温度分布を求める式は

$$T^{n+1} = T^{n} + \Delta t (-(u \cdot \nabla)T^{n} + \frac{1}{N_{R}^{n} + Pr^{n}} \Delta T^{n})$$
(3-12)

となる. レイノルズ数 Re^{n+1} とプラントル数 Pr^{n+1} は(3-7)式の T^{n+1} を用いて計算され,次の時間ステップ(n+2) Δt において使用される.

式(3-9)で得られたノズル出口における流速分布より噴流偏向角 θ を求める.ノズル 出口でのノズル中心軸を境にして,壁面常温側,及び壁面高温側の運動量をそれぞれJ₁, 及びJ₂とすると,

$$J_{1} = \int_{0}^{\delta} \rho u^{2} dx + \int_{\delta}^{\frac{1}{2}b_{s}} \rho u_{m}^{2} dx$$
$$= \rho u_{m}^{2} \left[\int_{0}^{\delta} \left\{ \frac{2}{\delta} x - \left(\frac{1}{\delta} x\right)^{2} \right\}^{2} dx + \int_{\delta}^{\frac{1}{2}b_{s}} dx \right]$$

$$= \rho u_{m}^{2} \left(\frac{1}{2} b_{s} - \frac{7}{15} \delta \right)$$

$$J_{2} = \int_{0}^{\delta'} \rho u^{2} dx + \int_{\delta'}^{\frac{1}{2} b_{s}} \rho u_{m}^{2} dx$$

$$= \rho u_{m}^{2} \left[\int_{0}^{\delta'} \left\{ \frac{2}{\delta'} x - \left(\frac{1}{\delta'} x \right)^{2} \right\}^{2} dx + \int_{\delta'}^{\frac{1}{2} b_{s}} dx \right]$$

$$= \rho u_{m}^{2} \left(\frac{1}{2} b_{s} - \frac{7}{15} \delta' \right)$$
(3-14)

ここで、 u_a はノズル出口の流速最大値、 δ は常温壁側・ δ 、高温壁側の境界層厚さであり、 式(3-6)より求める.供給ノズル出口の噴流偏向角度 θ は、

$$\theta = \Gamma \tan^{-1} \left(\frac{J_1 - J_2}{J_1 + J_2} \right)$$
(3-15)

となる. ここで、Γは実験により求まる係数である.

よって、出力ポート入口における噴流偏向変位∆y₀は、

$$\Delta y_o = x_{sp} \tan \theta \tag{3-16}$$

となる.

3.3.2 出力特性

素子の供給特性は、供給流量と供給圧力との関係である.この関係は、供給動作点抵 抗*R*sによって定義され、他のすべてのインピーダンスが導かれるために重要なものであ る.供給インピーダンスは、供給ノズルに沿った圧力差と供給流量*Q*sとの比で定義され る.供給ノズルの出口の静圧は、ベント圧*P*vより得られる.それゆえ、供給動作点抵抗 は、バイアスゼロの状態で導き出せる.

$$Rs = \frac{Ps - Pv}{Qs} \tag{3-17}$$

ノズルからの排出流量は、ベルヌーイの式により、圧力差の平方根とノズル面積*bsh*と流量係数*Cd*に関係があり、次のように表される.

$$Qs = C_d b_s h_v \sqrt{\frac{2(Ps - Pv)}{f \ \ddot{I}}}$$
(3-18)

ここで,ρは流体密度,b_sは供給ノズル幅,hは供給ノズル高さである.流量係数は, 次のような修正レイノズル数N_R'の関数となる³⁵⁾.

$$C_d = f(\mathbf{N}_{\mathsf{R}}') \tag{3-19}$$

ただし,

5≤N'_R≤100のとき

 $C_{d} = -0.03422 + 0.0569445 N_{R}' - 2.305652 \times 10^{-3} N_{R}'^{2} + 5.13 \times 10^{-5} N_{R}'^{3} - 6.2507 \times 10^{-7} N_{R}'^{4} + 3.93475 \times 10^{-9} N_{R}'^{5} - 1.004255 \times 10^{-11} N_{R}'^{6}$

(3-20. a)

 $100 \le N'_R \le 200$ のとき

$$Cd=7.8 \times 10^{-3} N_{\rm R}$$
'+0.624 (3-20.b)

$$N'_{R} = \frac{(b_{s}/\nu)\sqrt{2(P_{s}-P_{\nu})/\rho}}{X_{eff}(1+1/\sigma)^{2}}$$
(3-21)

ここで,

Xeff - 供給ノズルにおいて、同じ抵抗を持った直管の有効長さで

あり、 $X_{eff}=X_{th}+1$ と、最も滑らかなノズルに近似できる.

*X*_{th} – ノズルロートの直線部分の長さを無次元化したもの.

 σ - ノズルのアスペクト比(= h/b_s).

式 (3-21)の分子は単にレイノルズ数であり、ノズル幅とベルヌーイ速度に基づいている.

$$N_{R} = \frac{b_{s}}{v} \sqrt{\frac{2(Ps - Pv)}{\rho}}$$

式 (3-18)を式 (3-17)に代入して,供給インピーダンスは次のように表現される.

$$Rs = \frac{1}{Cdb_s h} \sqrt{\frac{\rho(Ps - Pv)}{2}} = \frac{\mu}{2} \frac{N_R}{Cdb_s^3 \sigma}$$
(3-22)

中心流速の速度分布は、sech関数の2乗のつり鐘型にかなりよく似合う曲線が描ける.

単位当たりの総和流量は、単位深さ当たりの流量に等しい.ノズルの流量係数C_dが2項の積で表されると考えれば、それらはまず壁面による影響でありもう1つは境界面による影響である.

$$C_{d} = \left[1 - \frac{2\delta_{1}^{*}}{b_{s}}\right] \left[1 - \frac{2\delta_{2}^{*}}{b_{s}\sigma}\right] = C_{dbs}C_{dh}$$
(3-23)

ここで、 δ_{i} は排除厚であり、 C_{dbs} と C_{dh} はそれぞれ幅と高さの係数である、大抵の場合、排除厚はある値に非常に近づいたものとなる.

従って、 $\delta_1^* = \delta_2^*$ とすれば

$$C_{dbs} = \frac{1 - \sigma}{2} + \sqrt{\frac{(\sigma + 1)^2}{4} - \sigma(1 - C_d)}$$
(3-24)

つり鐘型の速度分布, $u = u_{max} \operatorname{sec} h^2 \left(K_l \frac{y}{b_s} \right)$ を持つ噴流は, 次式の流量を持つ.

$$b_s \int_0^\infty u d\left(\frac{y}{b_s}\right) = u_{\max} \frac{b_s}{K_1} \left[\tanh\left(K_1 \frac{y}{b_s}\right) \right]_0^\infty = u_{\max} \frac{b_s}{K_1}$$

この流量は、供給流量の単位深さ当たりの噴流中心軸の流量

$$Q_{smid} = C_{dbs}b_s \sqrt{\frac{2(P_s - P_v)}{f \ddot{I}}} = C_{dbs}b_s u_{max}$$
に等しくなければならない。
$$\frac{u_{max}b_s}{K_1} = \frac{C_{dbs}b_s u_{max}}{2}$$
(3-25)

あるいは,

$$K_1 = \frac{1}{C_{dbs}/2}$$
(3-26)

従って,ノズル端から下流方向の適当な距離においての速度分布は,次式として表される.

$$\frac{u}{u_{\text{max}}} = \sec^2 \frac{y/b_s}{C_{dbs}/2} \tag{3-27}$$

出力ポートが閉じられ出力流量がない場合における,噴流変位 Δy_o と出力圧力 ΔP_o の 関係は,出力ポート入口に衝突する主噴流の速度分布が圧力に回復する効率をいかに評 価するかが問題となる.そこで,出力ポート入口に衝突する主噴流がもつ運動量の変化 が回復圧力を決定するものとして以下の議論を進める. 出力ポート付近に到達する噴流の速度分布は式 (3-27)で与えられる.

$$u_o = u \max \sec h^2 \left(K_1 \frac{y}{b_s} \right)$$

噴流の中心流線が素子の対称線からΔy₀だけずれたとき,左右の出力ポートからスピルオーバーする流体の単位深さ当たりの運動量変化の総和F_R, F_Lはそれぞれ, Fig. 3-5 に示すように出力ポートに到達する速度分布を等価的にずらし,出力ポートの幅方向に 沿って積分することにより求められる.

$$F_R = \int_{-\Delta y_o}^{b_o - \Delta y_o} C_r \rho u_o^2 dy \tag{3-28}$$

$$F_{L} = \int_{-b_{0}-\Delta y_{0}}^{-\Delta y_{0}} C_{r} \rho u_{0}^{2} dy \qquad (3-29)$$

ここで, C, は運動量変化が出力圧力に関係する度合いを示す関数であり, 次式によって定める.

$$C_r = C_{rm} \operatorname{sec} h^2 \left(K_1 \frac{y}{b_s} \right)$$
(3-30)



Fig. 3-5 Flow of deflection jet in the vicinity of leading edge of splitter

よって、 F_R , F_L は

$$F_{R} = \int_{-\Delta y_{o}}^{b_{o}-\Delta y_{o}} C_{r} \rho u_{o}^{2} dy = C_{rm} \rho u_{\max}^{2} \int_{-\Delta y_{o}}^{b_{o}-\Delta y_{o}} \sec h^{6} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) dy$$
$$= C_{rm} \rho u_{\max}^{2} \frac{b_{s}}{5K_{1}} \left[\frac{\sinh \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right)}{\cosh^{6} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right)} + 4 \left\{ \tanh \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) - \frac{1}{3} \tanh^{3} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) \right\} \right]_{-\Delta y_{o}}^{b_{o}-\Delta y_{o}}$$
(3-31)

$$F_{L} = \int_{-b_{o}-\Delta y_{o}}^{-\Delta y_{o}} C_{r} \rho u_{o}^{2} dy = C_{rm} \rho u_{\max}^{2} \int_{-b_{o}-\Delta y_{o}}^{-\Delta y_{o}} \operatorname{sec} h^{6} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) dy$$

$$= C_{rm}\rho u_{\max}^{2} \frac{b_{s}}{5K_{1}} \left[\frac{\sinh\left(K_{1}\frac{y}{b_{s}}\right)}{\cosh^{6}\left(K_{1}\frac{y}{b_{s}}\right)} + 4\left\{ \tanh\left(K_{1}\frac{y}{b_{s}}\right) - \frac{1}{3}\tanh^{3}\left(K_{1}\frac{y}{b_{s}}\right) \right\} \right]_{-b_{o}-\Delta y_{o}}^{-\Delta y_{o}}$$
(3-32)

$$F_{R}$$
, F_{L} により出力圧力 ΔP_{o} は供給圧力 P_{s} で無次元化して

$$\frac{\Delta P_o}{P_s} = \frac{(F_R - F_L)/b_o}{P_s} = \frac{(F_R - F_L)/b_o}{\frac{1}{2}\rho U_s^2}$$

$$= \frac{2C_{rm\mathcal{U}\max^2}}{5K_1B_o U_s^2} \left[\left[\frac{\sinh\left(K_1\frac{y}{b_s}\right)}{\cosh^6\left(K_1\frac{y}{b_s}\right)} + 4\left\{ \tanh\left(K_1\frac{y}{b_s}\right) - \frac{1}{3}\tanh^3\left(K_1\frac{y}{b_s}\right) \right\} \right]_{-\Delta y_o}^{b_o - \Delta y_o}$$

$$- \left[\frac{\sinh\left(K_1\frac{y}{b_s}\right)}{\cosh^6\left(K_1\frac{y}{b_s}\right)} + 4\left\{ \tanh\left(K_1\frac{y}{b_s}\right) - \frac{1}{3}\tanh^3\left(K_1\frac{y}{b_s}\right) \right\} \right]_{-\Delta y_o}^{-\Delta y_o}$$
(3-33)

により求められる.

ただし, $B_o = \frac{b_o}{b_s}$ であり, b_s によって無次元化された出力ポート幅である.

出力特性は、与えられた噴流位置における出力流量の変化に対する出力圧力の変化で あり、この特性は出力インピーダンスを評価することである.出力インピーダンスは、 出力流路の抵抗に依存する.

出力流路の抵抗Rocは線形抵抗に加え、非線形抵抗を持ち次式のように表せる.

 $R_{oc} = R_{oL} + K_2 Q_o$ (3-34) R_{oc} は出力ポート入口の幅 B_o , 流路長さ X_o を用いて式 (3-25)から求められ, 流量 Q_o に

66

対する,出力ポートに衝突するときの平均総合圧力*P*₊(*Q*₀)と出力ポート圧力との差の 比で表される.

$$\frac{P_{+}(Q_{o}) - P_{o}}{Q_{o}} = R_{oc} \tag{3-35}$$

ここで平均総合圧力 $P_+(Q_0=0)$ は F/b_0 を表す. 出力ポートで $Q_0=0$ の時の平均総合圧力 $P_+(Q_0=0)$ は回復圧力である. 供給ノズルから流出した供給総合圧力は, 3つの粘性損失 に依存する.

1)供給ノズルにおける損失

2)上下の壁面による損失

3) スプリッタで発達する境界層による損失

出力ポートでの回復圧力はスプリッタによって噴流を分割して,出力ポートに入る流 量の運動量J₀を垂直方向に変化させる働きがある.

一方の出力ポートの回復圧力 P_t は, 噴流が中心にある場合に運動量流束 J_0 の $\frac{1}{2}$ である.

$$P_{t} = P_{+}\Big|_{Q_{0}=0} = \frac{J_{0}}{2b_{0}h}$$
(3-36)

出力ポートでの運動量流束は,理想的な運動量流束($J_{s,id} = 2P_{sbsh} = \rho V_s^2 b_{sh}$)から,次式 となる.

$$J_{o} = \frac{J_{s}}{J_{s,id}} \frac{J_{sp}}{J_{s}} \frac{J_{o}}{J_{sp}} J_{s,id}$$

$$J_{o} = 2C_{\theta}C_{\theta X sp}C_{\theta B sp}P_{s} b_{s} h \qquad (3-37)$$

供給ノズルにおける損失は,流れが完全に発達しているならば,速度分布が垂直水平 方向に放物状になるという仮定のもとに運動量流束流出係数は,

$$C_{\theta} = 1.15Cd^2 \tag{3-38}$$

によって与えられる.なお壁面とスプリッタの損失をCexxp, CeBxp とする.境界層に依存 する運動量流束の損失は,垂直方向に放物状の速度分布を持つと仮定することによって, 簡単に評価できる.下流方向での運動量の損失は,せん断力を運動量流束に置き換える ことによって得られる.

速度分布は,

$$\frac{u(z)}{U\max} = 1 - \left(\frac{z}{h/2}\right)^2 \tag{3-39}$$

ここで,

u - 下流分速度.

z - 垂直座標.

Umax - 縦断面における最大速度.

アスペクト比0.3≤σ≤3で,充分発達した流れ

 $U_{\max} \cong 2\overline{u}$

平均流速 症は,

$$C_d U_s = C_d \sqrt{\frac{2(P_s - P_v)}{\rho}}$$

Cd>0.5で

$$U_{\max} = \sqrt{\frac{2(P_s - P_v)}{\rho}}$$

式 (3-39)からせん断力では,次式となる.

$$\tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{h/z} = -\frac{4U_{\max}\mu}{h}$$
(3-40)

 C_{d}
く0.5で、 $P_{s} = \rho U_{s}^{2}/2$ によって無次元化すると.

$$\frac{\tau_w}{P_s} = -\frac{16C_d}{\sigma N_R} \tag{3-41.a}$$

Ca≥0.5に対しては次式をとる

$$\frac{\tau_w}{P_s} = -\frac{8}{\sigma N_R} \tag{3-41.b}$$

単位深さ当たりの正味の力は、2x_wx_{sp} である.これは、ニュートンの第2法則より単 位深さ当たりの運動量流束の差(*J*_{sp} – *J*_s)/*b*_s に等しくなければならない.

ゆえに,

$$\frac{J_s - J_{sp}}{b_s} = 32C_d P_s X_{sp} / (\sigma N_R) \qquad (C_d < 0.5 \text{ Obs})$$
$$= 16P_s X_{sp} / (\sigma N_R) \qquad (C_d \ge 0.5 \text{ Obs}) \qquad (3-42)$$

$$\frac{J_{sp}}{J_s} = 1 + \frac{J_{sp} - J_s}{J_s} \downarrow \mathcal{V},$$

$$\begin{aligned} \frac{J_{sp}}{J_s} &= C_{ax_{sp}} = 1 - 16 C_d X_{sp} / (\sigma N_R C_{\theta}) \quad (C_d < 0.5 \, \sigma \, \& \, \& e) \\ &= 1 - 8 X_{sp} / (\sigma N_R C_{\theta}) \quad (C_d \ge 0.5 \, \sigma \, \& \, \& e) \end{aligned} \tag{3-43} \\ \text{ここで, } X_{sp} &= x_{sp} / b_s \; (\text{大文字の次元は, } b_S \text{によって無次元化されている.}) \end{aligned}$$

有限幅の境界層, スプリッタの円筒形のエッジを, Fig.3-6に示す.



Fig. 3-6 Flow of the leading edge of splitter

円筒の先端での運動量と排除厚, θとδ は次式となる.

$$\frac{2\theta}{r}\sqrt{\frac{U_{\infty}r}{v}} = 0.6$$

$$\frac{\delta^{*}}{r}\sqrt{\frac{U_{\infty}r}{v}} = 0.8$$
(3-44)

ここで, $r/b_s = B_{sp}/2$, U_0 は衝突噴流の平均速度. これらの値は高いレイノルズ数 N_R に対して理想的である.

衝突によるJ_{sp}と円筒の先端での運動量流束J₀の比は,

$$\frac{J_o}{J_{sp}} = \frac{\rho U_o^2 h \left| b_s / 2 - (\theta + \delta^*) \right|}{\rho U_o^2 h (b_s / 2)} = 1 - \frac{\theta + \delta^*}{b_s / 2}$$
(3-45)

式 (3-44)
$$U_o = C_d \sqrt{\frac{2(P_s - P_v)}{\rho}}$$

と

$$\frac{r}{b_s} = \frac{B_{sp}}{2}$$

から,

$$\frac{J_o}{J_{sp}} = 1 - \frac{1.1B_{sp}}{\sqrt{C_d N_R (B_{sp}/2)}}$$
(3-46)

回復圧力は、式(3-37)から次のようになる.

$$P_{t} = \frac{C_{\theta} \left[\frac{1 - 16C_{d}X_{sp}}{\sigma^{2}N_{R}C_{\theta}} \right] \left[1 - \frac{1.1B_{sp}}{\sqrt{C_{d}N_{R}(B_{sp}/2)}} \right]}{B_{\sigma}} \qquad (C_{d} < 0.5 \text{ Or } \succeq \textcircled{e})$$
$$= \frac{C_{\theta} \left[\frac{1 - 8X_{sp}}{\sigma^{2}N_{R}C_{\theta}} \right] \left[1 - \frac{1.1B_{sp}}{\sqrt{C_{d}N_{R}(B_{sp}/2)}} \right]}{B_{\sigma}} \qquad (C_{d} \ge 0.5 \text{ Or } \succeq \textcircled{e})$$

(3-47)

Fig. 3-6に示すように有限の負荷抵抗を通過して出力流量がある場合,出力ポートの 先端に衝突した噴流は2つの流れに大別されるものとする.1つは出力ポートを通過で きる流れ,すなわち出力流となる部分であり,これは衝突する噴流の速度分布の中心付 近を占める高速流からなる.もう1つは,残りのより低速部分からなりこの部分は出力 ポートに入れず,出力ポート先端付近でほぼ90°向きを変えて,ベントに流れ出るも のと単純化したものである.従って,これら2種類の流れが出力に寄与する程度も異な る.すなわち,出力ポート先端に加わる流体力は,高速で出力ポートを通過する部分の 動圧による力と,スピルオーバする残りの低速部分の運動量の変化による力からなると 考えられる.

また,噴流はスプリッタ先端に衝突して,スプリッタ壁に沿って流れるので,境界層 が発達する.従って,排除厚さの分だけ噴流が押し広げられることになり,速度分布の 積分に際し,素子の出力ポート幅boよりも小さな値をもつ有効出力ポート幅boeを用い る必要がある.

出力流量*q₀は*噴流の出力ポート先端における速度分布*u₀*の中心からある距離*b*までの 部分からなるとすれば、次式で示される.

$$q_o = h \int_0^b u_o dy \tag{3-48}$$

ここで、hは素子の深さであり、yは噴流軸に直角な軸である.出力ポート先端に到達 する噴流の速度分布は式(3-27)で表される.

$$u_o = u \max \sec h^2 \left(K_1 \frac{y}{b_s} \right)$$

従って、出力流量q₀は次式となる.

$$q_{o} = h \int_{0}^{b} u_{\max} \operatorname{sec} h^{2} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) dy$$
$$= h u_{\max} \frac{b_{s}}{K_{1}} \left[\tanh \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) \right]_{0}^{b} = \frac{u_{\max} b_{s} h}{K_{1}} \tanh \left(K_{1} \frac{b}{b_{s}} \right)$$
(3-49)

上式により,出力流量に対応するbの値が算出される.この流れが出力ポート先端で もつ流体力F_{id}は動圧の総和として見積もられ,次式で表される.

$$F_{id} = \frac{\rho}{2} \int_{0}^{b} u_{o}^{2} dy = \frac{\rho}{2} \int_{0}^{b} u_{\max} \sec h^{2} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) dy$$

$$= \frac{\rho u_{\max}^{2}}{2} \frac{b_{s}}{K_{1}} \left[\tanh \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) - \frac{1}{3} \tanh^{3} \left(K_{1} \frac{y}{b_{s}} \right) \right]_{0}^{b}$$

$$= \frac{\rho u_{\max}^{2} b_{s}}{2K_{1}} \left[\tanh \left(K_{1} \frac{b}{b_{s}} \right) - \frac{1}{3} \tanh^{3} \left(K_{1} \frac{b}{b_{s}} \right) \right]$$
(3-50)

スピルオーバする流体の運動量変化の総和Fimは次式により計算される.

$$F_{im} = \rho \int_{b}^{boe} u_o^2 dy = \rho \int_{b}^{boe} u_{\max} \operatorname{sec} h^2 \left(K_1 \frac{y}{b_s} \right) dy$$
$$= \rho u_{\max}^2 \frac{b_s}{K_1} \left[\tanh \left(K_1 \frac{y}{b_s} \right) - \frac{1}{3} \tanh^3 \left(K_1 \frac{y}{b_s} \right) \right]_{b}^{boe}$$
$$= \frac{\rho u_{\max}^2 b_s}{K_1} \left[\tanh \left(K_1 \frac{b_{oe}}{b_s} \right) - \frac{1}{3} \tanh^3 \left(K_1 \frac{b_{oe}}{b_s} \right) - \frac{1}{3} \tanh^3 \left(K_1 \frac{b_{oe}}{b_s} \right) - \tanh \left(K_1 \frac{b_{oe}}{b_s} \right) + \frac{1}{3} \tanh^3 \left(K_1 \frac{b_{oe}}{b_s} \right) \right]$$
(3-51)

有効積分幅 b_{oe} は、排除厚さを δ 、スプリッタ幅を b_{sp} 、動粘性係数をvで表せば次式となる.

 $b_{oe} = b_o - \delta$

$$\delta = \frac{1.6b_{sp}}{\sqrt{u_{\text{max}} b_s / (2f)}} \dot{\mathbf{I}}$$
(3-52)

これら2つの流体力により、出力ポート先端に加わる全圧Poiは次式で表される.

$$P_{oi} = \frac{1}{b_o} \left(F_{id} + F_{im} \right) \tag{3-53}$$

従って、出力流路の抵抗をRocとすれば、出力圧力Poは次式で表される.

$$P_o = P_{oi} - R_{oc}Q_o \tag{3-54}$$

式 (3-54)によって出力特性, P_0-Q_0 曲線が計算される.ここで, 出力流路の抵抗 R_{oc} は, 式 (3-18)と B_0 , X_0 から次式で与えられる.

$$\frac{R_{oc}}{R_{s}} = \frac{24X_{o}C_{d}}{\overline{B}_{o}{}^{2}\sigma N_{R}} \left(\frac{\overline{B}_{o}}{\sigma} + \frac{\sigma}{\overline{B}_{o}} + K\right) + \frac{0.95C_{d}{}^{2}}{B_{o}\min}{}^{2}\frac{q_{o}}{Q_{s}}$$

$$1 \le \frac{\sigma}{\overline{B}_{o}} \le 2 \mathcal{O} \succeq \stackrel{>}{\equiv} 0.35 \le K \le 0.5 \quad ; \quad \frac{\sigma}{\overline{B}_{o}} > 2 \mathcal{O} \succeq \stackrel{>}{\equiv} K = 0.5$$

$$(3-55)$$

3.4 実験結果

3.4.1 光流体変換器の製作

温度と速度場の測定を可能にするために,光流体変換器(Fig.3-1)における1段 目の光流体変換部を4倍拡大したモデルを作成した(Fig.3-7).供給ノズル幅 1.52[mm],厚さ5[mm]である.光信号は,幅2[mm]のファイバを供給ノズル片側 に埋め込み素子に入力した.

変換部が大きくなると、変換部内の噴流が乱流になり易く入出力ゲインが著 しく低下したり、ノイズが発生する可能性が考えられる.そのため、実験をお こなうにあたり使用する4倍拡大モデルが、このような影響を受けない妥当な 設計であるかを調べる必要がある.実際の光流体変換部では出力圧力差が微弱 で測定が困難なため、ゲイン特性を拡大モデルと直接比較することができない. そこで、実験で用いる拡大モデルと同寸法の4倍拡大LPA素子を制作した.実験 装置の概略図をFig.3-8に示す.拡大モデルはワイヤーカット放電加工機で制作 し、供給ノズル幅は1.52[mm]、厚さは2[mm]、アスペクト比は通常のLPAと同様 に1.32である.供給ポートには100あるいは200[Pa]の空気圧を供給し、入力ポ ートから圧力差信号を入力したときの出力圧力差を測定した.出力圧力差は微 圧測定用半導体圧力センサにより測定を行なった.実験結果をFig.3-9に示す. また、実験結果と標準寸法のLPAのゲインを比較したものをTable.3-1に示す.

供給圧力(Pa)	100	200
標準 LPA	11.2	11.4
4倍拡大モデル	6.3	6.4

Table. 3-1 Pressure gain

実験結果より、拡大モデルはゲインの低下が見られるが、ノイズも出ず良好 な直線性が得られていることが確認されたので、4倍拡大モデルは装置として 妥当であるとみなし、以下では4倍拡大モデルを用いて解析実験を行なった.

光流体変換部の拡大モデルを用いて,光信号から流体信号に変換する際の供 給噴流の温度・速度分布の測定実験をおこなう.実験装置の概略図を Fig. 3-10 に示す. 拡大モデルは, 供給ノズル幅は1.52[mm], 厚さは5[mm]である. 温度・ 速度は熱線流速計(カノマックス製)および熱線温度計(TSI 製)に接続された熱 線プローブ(直径 25μm)を素子内に挿入しそれぞれの分布を測定する.

光信号の入力方法は、実際の回路と同様に光ファイバを用いて行う.幅2[mm] の光ファイバの端面に光吸収体としてカーボンブラックを塗布し、供給ノズル 側壁の片側のみに埋め込み片側入力とした.光信号はオリンパス製のハロゲン ランプ(TE-2)を用いレンズ系で集光させ光ファイバの端面より入力した.

3.4.2 光流体変換器の温度・速度分布解析

光流体変換部噴流口の温度分布の実験結果をFig. 3-12に示す. グラフより光 照射側の噴流温度が最大で約25℃ほど上昇し,ノズル内に温度境界層が存在す ることが確認された.入力パワーの変化に比例して光照射側壁面温度が変化し ている.次に,理論値と実験値との比較結果を下記に示す.数値解析では噴流 口付近の1.52mm×3.00mmの範囲を20×20の等間隔長方形格子に分割し解析を行 う(Fig. 3-11).数値解析における壁面の境界条件は,実験により求まった壁面 温度を代入し・壁面の圧力は近傍の圧力を代入し・流速は零を代入する.流入 口は流速・圧力・温度一定の境界条件を与え流路内の温度・速度分布を計算し た.入力パワー30W時の実験結果と数値解析結果を比較している.Fig. 3-13より 理論値と実験値の間に精度の高い一致が見られた.光照射時と非照射時の速度 分布測定結果と数値解析結果をFig. 3-14に示す.破線が非照射時,実線が照射 時の流速分布である.速度分布では噴流偏向量が微少なため差を拡大して示し ている.測定結果より光照射側壁面の速度が低下し光エネルギによって噴流が 偏向しているのがわかる.また,数値解析結果でも測定結果と同じ傾向が見ら れており,素子内の噴流流れの様子をよく表しているものと思われる.

次に,噴流部の素子内流れの速度分布を比較する.数値解析は噴流下流部の 4.60mm×15.0mmの範囲を40×30の等間隔長方形格子に分割して解析する (Fig.3-15).数値解析の境界条件は,流入条件は噴流口の流速・圧力の実験値 を用い,側面は大気圧開放とする.ベントベーン,スプリッタ部は壁面として 扱い変換器内の流速・圧力分布を計算する.また,実験は噴流口から下流3mm,

ベントベーン部,スプリッタ部の3箇所で測定を行った(Fig.3-16).X軸の正方 向からプローブを挿入するためスプリッタを取り外した状態で測定を行った. 光照射時と非照射時の速度分布測定結果と数値解析結果をFig.3-17,18,19に示 す.Fig.3-13と同様,偏向量が微少なため差を拡大してグラフにしている.

破線が非照射時の流速分布,実線が光照射時の流速分布である.非照射側の 流速が低下しており,下流に行くにしたがって流速分布はなだらかとなるがそ の傾向は変わらない. 噴流の偏向量は,数値解析結果では流速変化の割合が小 さいため噴流口から 3 mm下流の流速最高値の座標の中心からの距離は,座標中 心から 0.017 mm非照射側の偏向である. スプリッタ部における偏向量も 0.017 mmである. 噴流はこれ以上偏向していないことがわかる. これは空気の粘性変 化による噴流偏向効果があまり大きくなく,そのため偏向量が微少なためと考 えられる. 測定結果も同様であった.

以上より,数値解析結果と傾向が一致し,提案した数値解析モデルが妥当な ものであることが明らかとなった.

3.4.3 光流体変換器の変換特性

光流体変換器の拡大モデルを用いて、入力パワーに対する出力圧力差を測定 し変換ゲイン特性を求めた.実験装置の概略図をFig.3-20に示す.実験に用い た光流体変換器の寸法はFig.3-7に示す.実験結果と比較するため供給ノズル出 ロの左右の運動量J1、J2をシミュレーションにより求めた.そして、式(3-3)か ら出力ポート入口での噴流偏向変位Δyoを、式(3-33)から出力圧力差ΔPoを求 めた.拡大モデルの出力圧力差とシミュレーション結果の比較結果をFig.3-21 に示す.縦軸が出力圧力差、横軸が光源の入力パワーである.実験結果は供給 圧力が100および150[Pa]の各圧力のときに入力パワーを0~150[W]まで変化さ せた結果である.実験結果より入力パワーが同じ場合でも供給圧力を上げると 出力圧力差が増加することがわかる.シミュレーション結果と比較して、ベン トを大気圧開放していることによるノイズの影響などでばらつきがあるが、理 論値と実験値はほぼ一致していると言え、本章で提案した光流体変換特性の解 析モデルの妥当性が実証された.



Fig 3-7 Large-scale model of the practical opto-fluidic interface element







Fig. 3-9 Pressure gain characteristics of LPA



Fig. 3-10 Experimental layout for measurement of fluid velocity and temperature distribution



Fig. 3-11 Calculated flow field in opto-fluidic interface at nozzle



Fig. 3-12 Measured temperature distribution in nozzle flow



Fig. 3-13 Comparison between calculated value and measured value of temperature distribution in nozzle flow



(a) Calculated value



(b) Measured value Fig. 3-14 Velocity distribution of jet flow at nozzle



Fig. 3-15 Calculated flow field in opto-fluidic interface



Fig. 3-16 Measurement point of flow velocity distribution



(a) Calculated value



(b) Measured value Fig. 3-17 Velocity distribution of jet flow at point1



(a) Calculated value



(b) Measured value Fig. 3-18 Velocity distribution of jet flow at point2



(b) Measured value Fig. 3-19 Velocity distribution of jet flow at point3



Fig. 3-20 Experimental layout for measurement of output differential pressure



Fig. 3-21 Output of differential pressure

3.5 まとめ

本章では、電気信号を介さず光信号を流体信号に直接変換する方式として、 光信号により境界層を制御する光流体変換システムを提案した.本章を要約す ると以下のようになる

- これまでに明らかになっていなかった光流体変換器における噴流の温度・ 速度分布を拡大モデルを用いて測定実験をした.数値解析法としてSMA C法を用いることによって理論解析モデルを提案し素子内の流れを解析した.測定結果と解析結果を比較することによって数値解析モデルが妥当な ものであると実証できた.
- 2) 光流体変換素子の拡大モデルを用いて、光強度に対する出力圧力差を測定し変換ゲイン特性を求めた.理論値と実験値はほぼ一致していると言え、本章で提案した光流体変換特性の数値解析モデルの妥当性が実証された。

第4章 光流体サーボシステムの開発と応用

4.1 はじめに

本章は光流体変換器を用いた光流体サーボシステムの実用化について示したもので ある.従来の流体制御システムは2章で述べたように電気信号が使われている.流体制 御システム,特に空気圧システムはエネルギ媒体の空気圧を容器内に蓄積可能なため 自律機器として医用や家庭内などの広いフィールドで利用することが可能である.こ のようなフィールドではノイズによる誤動作の回避や人や危険物への安全から光によ る信号伝達が望まれる.また,従来のFAなどのフィールドでもコンピュータとの光通 信が進展しており光による制御が有望である.このような観点から流体アクチュエー タすなわち空気圧ロータリアクチュエータに駆動されるロボットアームの制御および 圧力制御を例にとり提案する光流体変換器を用いた流体制御システムの構築を行う.

空気圧アクチュエータを動作させるには最大で1MPa程度の高い圧力が必要であ り、現在の光流体変換器ではこの出力は得られない。何らかの機器により規定の圧力 まで増幅する必要があり、本章では膜型増幅器を使った場合と光流体変換器出力を空 気圧サーボ弁のパイロット圧として使うことにより増幅した場合について示し、その 性能評価を行う。

4.2. 膜型流体増幅器を使ったロボットアーム制御システム

4.2.1 システム構成

本節で使用する空気圧駆動ロボットシステムの概略図を Fig.4-1 に示す. このシス テムは、マイクロコンピュータ、光流体変換器、光エンコーダ、LPA、膜型流体増 幅器、ロボットアームから構成されている. ロボットアームのアクチュエータは空気 圧ロータリーアクチュエータである.

ロボットアームの関節部に取り付けてある光エンコーダよりロボットアームの変位 信号が検出され、コンピュータに取り込まれる.下記で示す制御則によってレーザの 光強度を決定し、D/Aコンバータとレーザ駆動回路を介してレーザを点灯する. レーザダイオードよりの光信号は、光ファイバを介して光流体変換器に入力され、光 流体変換器の出力口より差圧式圧力信号に変換されて出力される.光流体変換器から 出力された圧力差は,圧力増幅用LPAの制御口に入力される.LPAの出力口から出力 される増幅された圧力はそれぞれの膜型流体増幅器に入力される. 膜型流体増幅器に おいてアクチュエータ駆動に必要なパワーとなるよう,圧力及び流量が共に増幅され る.2つの膜型流体増幅器からの出力圧力は,ロボットアームのロータリアクチュ エータに加えられ,その圧力差に連動してロボットアームが動作する.

本節で用いた膜型流体増幅器の概略図を Fig. 4-2 に示す. この膜型流体増幅器は, 単段ノズルフラッパ機構を有し,ノズル直径は,1.0(mm),フラッパ膜の直径は 33(mm) である.供給圧力は *Psm*=200(kPa)から 300(kPa)の範囲とする.LPAカスケード増 幅器からの出力を膜型流体増幅器に入力すると,フラッパが圧力により膨らみ,ノズ ルとフラッパの間の間隔が狭まり、ノズルの流出抵抗を増大させ、ノズル背圧が上昇 する.流量増幅は最終段の膜と流出ベントによって構成される部分により行われる.

本節で使用したロボットアームの構造を Fig. 4-3 に示す. このアームは, 空気圧 ロータリアクチュエータにより回転される2関節と2本の腕からなっている. ロータ リアクチュエータは直径 50 (nm), 長さ 60 (nm)の大きさの, 黒田精工社製のクロダハイ ロータ PRN-20A (最低駆動圧力 100kPa)である. 2本の腕は両方ともアルミニウム製で, 長さと重量はそれぞれ, 肩に近いほうから順に, 260 (nm), 600 (g), および, 150 (nm), 230 (g) である. ただし本研究では, 人間の肩関節にあたるアクチュエータのみを駆動 し, 人間の肘関節にあたるアクチュエータは固定した.



Fig. 4-1 Layout of experimental setup



Fig. 4-2 Scheme of booster amplifier



Fig. 4-3 Scheme of robot arm

本章では以下(a)(b)(c)3種の制御方式を用い実験を行う.

(a) P I 動作方式

時点kにおける目標値r(k)とプラント出力y(k)との誤差e(k)を

$$e(k) = r(k) - y(k) \tag{4-1}$$

と定義し、制御入力 u(k)は、比例ゲイン K_p 、積分ゲイン K_i 、サンプリングタイム T_s を用いて(4-2)式のように表される.

$$u(k) = K_{p} \left[e(k) + K_{i}T_{s} \sum_{i=0}^{k} e(i) \right]$$
(4-2)

(b) 最適制御方式

システムの状態変数 x(t)をアームの角度x(t),速度 $\dot{x}(t)$,アクチュエータ圧力 p(t)として状態方程式を形成する.入力u(k)は、算出されるフィードバック係数 F_1, F_2 から決定し、(4-3)式のように表される.ただし、連続時間系から離散時間系への変換は零次ホールダを用いた.

 $u(k) = -F_1 X(k) + F_2 Z(k)$ (4-3)

(c)外乱オブザーバを用いた P 動作制御

Fig. 4-4 のようなフィードバック系を構成し、プラントとノミナルモデルの誤差も含めた外乱を推定し、制御入力にフィードバックする.ここで、補償器 R=*e^{-Lt}、フィルタQ*を遮断周波数 0.8Hz の1次のものとし、コントローラCはゲイン3の比例動作である.



Fig. 4-4 Experimental controller using disturbance obserber

ここでは特性モデルによるシミュレーションを行い,その結果をもとにして各制御 方式におけるシステムの特性変化に対するロバスト性や外乱抑圧特性について考察す る.まず,本実験で使用するロボットアームの状態方程式を求めると次のようになる.

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A_{c} \mathbf{x}(t) + b_{c} \mathbf{u}(t)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -c/M & a/M \\ 0 & 0 & -1/\tau \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\tau \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) \quad (4-4)$$

$$\mathbf{y}(t) = c_{c} \mathbf{x}(t)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \theta & \dot{\theta} & T \end{bmatrix}$$

$$\theta : \mathcal{T} - \Delta \mathcal{O} \mathbf{\beta} \mathbf{g} [\deg]$$

$$\dot{\theta} : \mathcal{T} - \Delta \mathcal{O} \mathbf{\beta} \mathbf{g} [\deg]$$

$$\vec{\theta} : \mathcal{T} - \Delta \mathcal{O} \mathbf{\beta} \mathbf{g} [\deg]$$

$$T : \mathbf{\lambda} \mathbf{\beta} \in \mathcal{N} \mathcal{O} [\mathbf{N} \cdot \mathbf{m}]$$

$$\tau : \mathbf{B} \mathbf{c} \mathbf{g} [\mathbf{s}]$$

上式から伝達関数 G(s)は式(4-5)の様になる.

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + bs^2 + as} e^{\tau s}$$
(4-5)

ルンゲクッタ法を用いてシミュレーションを行った結果を以下に示す. また, このと きの各制御方式において使用した制御パラメータを Table 4-1 に示す.

Control method	Parameter					
PID action	<i>Kp</i> =5, <i>Ki</i> =2, <i>Kd</i> =1.4					
Optimal control	$Q = \begin{bmatrix} w & 0 & 0 \\ 0 & ww & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R=1$ $w=300 ww=30$					
Disturbance obserber	Nominal model : $\frac{7^{2}}{s(s+7)^{2}}$ Filter : $\frac{5}{s+5}$ Proportional gain : 3					

Table 4-1 Control parameter

まず最適制御則を導入するにあたり無駄時間は無視できるとして制御則を設計した が、実際は40ms 程度の無駄時間が存在するのでシミュレーションによりその影響を調 べた.特性モデルは式(4-5)を使用し、これに組み合わせる遅れ時間は0~100msの範 囲で10ms ずつ変化させて計算を行った結果をFig.4-5 に示す.この結果より無駄時間 が60ms までならば応答波形に大きな変化はみられない.しかし、80ms を越えると波形 が振動的になり過渡特性が悪化する.目標位置への整定時間は無駄時間が0ms から順 に、165、176、197、211、269、369ms となった.本システムにおいては無駄時間が40 ms であるので、特性の劣化は許容できる範囲内にあり無駄時間を制御則に考慮しな かったことが制御性能に大きな影響を与えないということがシミュレーションからわ かった.

Fig. 4-6 は,目標位置を5秒ごとに45度,20度,40度,0度と変化させた時のシ ミュレーション結果で,(a) P I D 動作,(b) 最適制御,(c) 外乱オブザーバによるもの である.最適制御と外乱オブザーバについては良好な結果が得られた.最適制御によ るものは,それぞれの目標変動に対して,1.96,1.78,1.72,1.92 秒で整定したが, 外乱オブザーバによるものはすべての目標変動に対して最適制御の結果より 30%早く 整定した.しかしながらPID動作については目標位置変動後の5秒間では整定せず 良い結果が得られなかった.ここで使用した制御パラメータは実験で用いるものと同 じ値としたが、シミュレーションでは静止摩擦力などの影響を考えていないので、実 際の動きと異なる場合もあると考えられる.

Fig. 4-7 は,目標位置を45度として10秒後にコントローラからの出力に対して,ソフトウェア的に一定外乱を5秒間あたえ,またもとに戻したときの結果である.この結果より,最適制御と外乱オブザーバは,一定外乱を除去し目標位置に復帰しているが,PID動作では復帰できていない.また,最適制御では,一定外乱の影響により誤差が最大で11度,目標に復帰するまでが2.24秒となっているが,外乱オブザーバではそれぞれ,4.2度,1.17秒となっており,外乱オブザーバの外乱抑圧特性が優れていることがわかる.

次にプラントのパラメータ変動に対するロバスト性についてシミュレーションを 行った. Fig. 4-8 はプラントの質量に関する項を5 倍にしたもので, Fig. 4-9 は粘性に 関する項を2 倍にしたもの, Fig. 4-10 は粘性に関する項を1/2 倍したものによる結果 である.

まず Fig. 4-8 から, P I D動作と最適制御は質量の変化に対しては 5 秒間では目標 位置に整定することはできていないが,外乱オブザーバでは目標変動から 4 秒後には 整定しいることがわかる.しかも,オーバシュート量も一番少なくなっている.

次に Fig. 4-9 から, P I D動作については粘性の変化がある場合は質量の変化の場合 Fig. 4-8 と同様に整定できていないが,最適制御については整定させることができている. また, Fig. 4-10 により粘性の減少の場合でも同じような結果が得られた.

これらの結果より、プラントのパラメータ変動に対するロバスト性に関しては、最 適制御はパラメータ変動に対して良好ではないが、原理的にステップ状の外乱に対し て適応できる1型サーボ系となっているので定常偏差は除去できる効果が示された.

次に実験結果を示す. ここで用いる制御パラメータは, Table 4-1 で示したシミュ レーションと同じものを用いている.

Fig. 4-11 は, 10 度から 90 度までのステップ波に対する各制御方式によるプラントの応答である.

(a)のPID動作によるものでは、目標位置が40度までの場合は直ちに整定できて

いるが、50度以上では10秒以内に整定させることはできなかった.

(b)の最適制御によるものでは目標位置が50度を越えるとオーバシュートを起こし, それ以下だとアンダーシュートを起こしてしまっている.しかし,最適制御ではすべ てに対して目標位置に整定している.

(c)の外乱オブザーバによるものは目標位置による応答の変化がほとんどみられず, オーバシュートもなく良い応答を示している.

それぞれの制御方式による,異なった目標位置に対する整定時間をTable4-2にまとめて示す.

Desired angle (deg)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
PID action	1.24	1.04	1.78	3.29	×	×	×	×	×
Optomal control	1.38	2.38	2.02	2.32	2.77	3.59	4.26	3.64	4.43
Disturbance obserber	0.81	0.76	0.88	0.93	1.36	2.01	2.49	2.48	2.27

Table 4-2 Rising time (s)

Fig. 4-12 は,目標位置を 45 度,20 度,40 度,0 度と5 秒ごとに変化させたものに 対する各制御方式によるアームの角度の応答である.ここでは,各制御方式とも良い 応答を示している.しかし(b)の最適制御では,アンダーシュートをおこし,他のもの にくらべ整定までに少し時間を要している.またPID動作では外乱オブザーバに比 べ,過渡状態の応答があまりよくなく整定時間も遅くなっている.

Fig. 4-13 は, Fig. 4-12 と同じ目標に対してアームの肘関節部分に1kg のおもりを負荷としてあたえたロボットアームの応答である.

(a)のPID動作では、5秒間の間に目標位置に整定することができず、負荷変動に 対するロバスト性が乏しいことがわかる.

(b)の最適制御においては目標位置に整定し安定性を保ったままで制御感度を上げられたことは確認できるが、オーバシュートの量が約10度あるなど、目標位置に対する移動量によって応答波形にばらつきがみられた.

(c)の外乱オブザーバにおいては、オーバシュートの量は最大でも3度以内で、整定時間についても負荷をかけない場合のFig.4-12(c)とくらべて約2倍で収まっており、 応答波形に大きな変化はみられず、負荷変動に対するロバスト性が3者の中で一番高 いことがわかる.

Fig. 4-14 は, 目標位置を 45 度として 10 秒後にソフトウェア的に一定外乱を 5 秒間

あたえ、その後解除した時の結果である.

ここでも(a)のPID動作は外乱を除去することができず目標に整定することができていない. これはシュミレーション結果と一致する.

(b)の最適制御では過渡的に外乱の影響を強く受け、約10度の偏差が発生した後に約3秒で目標位置に復帰している.



Fig. 4-5 Simulation result of various delay time (With optimal control)



Fig. 4-6 Simulation result (No load)



Fig. 4-7 Simulation result (Add in disturbance)



Fig4-8 Simulation result (Increasing mass)



Fig. 4-9 Simulation result (Decreasing mass)



Fig. 4-10 Simulation result (Decreasing viscosity)



Fig. 4.11 Experimental result of various step input



Fig. 4.12 Experimental result (No load)


Fig. 4.13 Experimental result (Addendum in load)



Fig. 4.14 Experimental result (Addendum in disturbance)

4.3 サーボ弁を用いた圧力制御システム

4.3.1 システム構成

光流体圧力制御システムの構成をFig.4-15に示す.光流体変換素子の出力を LPA増幅器により増幅しただけでは十分な出力圧力とならないので,さらに 3段LPAカスケード増幅器及び乱流型比例増幅素子で純流体的に増幅した後 に空気圧サーボ弁によりパワー増幅している.カスケード増幅器のLPAはい ずれもアスペクト比は1.03であるが,各段でLPAをそれぞれ2,2,3個並 列につなぎ流量的にも増幅している.さらに,2個並列につないだ乱流型比例 増幅素子によってパワー増幅し出力を空気圧サーボ弁に入力している.一般の サーボ弁が電気信号入力によって電磁力でスプールを駆動するのに対して,こ の空気圧サーボ弁は光流体変換された空気圧により直接弁内のスプールを左右 に移動させて出力圧力を調節する.概略図をFig.4-16に示す.

4.3.2 実験結果

本節では前節よりさらに流量及び,出力圧力の増幅度を上げるために乱流型 比例増幅素子(TPA)を光流体変換器の出力に接続している.TPA は LPA と同様の 形状を持つが供給圧を上げより速い噴流としたものである.噴流が乱流になる ために出力ノイズが発生したり,増幅ゲインが LPA より小さくなるが,より大 きな出力圧力・出力流量が得られる.光流体変換器への光入力と TPA の出力圧 力との関係を Fig. 4-17 に示す.この結果から,TPA を用いても光強度と出力圧 力の線形性は失われないことが分かる.サーボ弁のスプールを動かすためには 圧力だけでなく十分な出力流量が必要である.十分な流量が得られるように TP A を 2 個並列につないでいる.TPA 単体と並列の場合での出力圧力と出力流量 の積,すなわち出力パワー特性を比較して Fig. 4-18 に示す.この結果から TPA を並列につなぐことによって出力パワーが増加していることが分かる.空気圧 サーボ弁の供給圧力を 200 [kPa] として,入力部 A,B に TPA から一定圧力差をス テップ状に入力した時の A ポート(a),B ポート(b)の出力圧力値の時間的変化 を Fig. 4-19, Fig. 4-20 に示す.前者は TPA が単体の場合,後者は並列の場合で ある.単体と比べて並列の場合は流量が増えているために,立ち上がり時間が 短くなり特性曲線の傾きが大きくなっていることがこの結果から分かる.

空気圧サーボ弁の片側Aポート出力圧力を,光制御入力によるPID動作に よって制御した.その結果をFig.4-21,Fig.4-22に示す.Fig4-21はTPA単体の 場合で,無駄時間が5s,整定時間は60sである.無駄時間が大きくなる原因は スプールを動かすために必要な流量が得られないためである.この性能では実 用には適さない.そこでFig.4-22にTPAを並列に用いた場合の結果を示す.TPA からの流量を増やすことにより,スプールの反応は良くなり無駄時間が0.4s, 整定時間は25sである.無駄時間は92%,整定時間は50%短縮された.しかし, スプールの静止摩擦力の影響が大きく入力圧力が小さな領域ではスプールが動 きにくくなっていると考えられ目標値付近では応答速度が低下している.しか し光により直接100kPa程度の高い圧力が制御可能であることを示せた.光流体 変換器の改良により整定時間はさらに短縮できると考えられる.



Fig. 4-15 Layout of opto-fluidic servo system



Fig4.16 Pneumatic controlled air servo valve



Fig. 4-17 Conversion characteristics of opto-fluidic amplifier



Fig4.18 Output power of turbulent proportional amplifier



(a)Output port A





Fig4.19 Step response of air servo valve Supply pressure = 200[kPa] (By a single amplifier)







Fig4.21 Step response of optical servo valve by PID control (Drived by single amplifier)



Fig4.22 Step response of optical servo valve by PID control (Drived by two parallel amplifiers)

4.5 まとめ

本章では、光流体変換器を用いて電気信号を介さず光信号により直接流体制 御システムを制御することが可能であることを示した.本章を要約すると以下 のようになる.

- E力増幅装置として光流体変換器の出力圧力で動作するノズルフラッパ機構をもつ膜型増幅器を用いてロボットアームの制御を行った.しかし、膜型増幅器の増幅率が高く出力が不安定になる、またノズルフラッパ機構を持つため信号伝達遅れが大きいなど解決すべき問題点も残されたが、光制御信号により直接ロボットアームを直接駆動できることが証明された.
- 2) 光流体制御システムの実用化には、光流体変換器の出力圧力を高い信頼性で増幅する装置が不可欠であり、そのため圧力増幅装置として光流体変換器の出力圧力で動作するサーボ弁を開発した。光サーボ弁と呼ぶのがふさわしいこの装置は現状では0.2Mpa程度までの出力圧力が得られている。改良により従来の電磁力を利用した空気圧サーボ弁に置き換えることが可能であり、2章で示した種々の流体制御システムを光信号を用いて操作できる。

第5章 結論

本研究は光に制御される流体サーボシステムの開発に関する研究を行ったものである.本研究で得られた具体的な成果は以下のとおりである.

第2章では、一般に普及している機器を用いて流体制御システムの整備を行った.構造が複雑で特性の把握の困難なサーボ弁に置換する目的で、電磁弁による制御を提案した.電磁弁の限界周波数を超えた適度な周期で開信号と閉信号を交互に入力することにより、電磁弁を浮動状態とし弁の開閉に伴う圧力変動を取り除くことができた.この電磁弁浮動制御方式圧力制御では、従来の制御方式に比べ開閉限界周波数の低い安価な電磁弁を用いても必要とされる精度の実現が可能であった.一般に普及しているオンオフ制御を目的とした電磁弁を、さらに高度な目的を持つ高価なサーボ弁に置換できることを示した.例として、サーボ弁の代用としてシリンダの位置制御を行い良好な結果が得られた.また電磁弁は等温化圧力容器と組み合わせて流量制御弁としても有効であることも明らかとした.

空気圧シリンダの位置精度は十分でなく、この精度改善を行った.空気の漏 れを防止するために取り付けられている、シールのロッド移動速度の変化によ る特性の変化を考慮に入れることによって制御性能の向上を図った.シールが シリンダ内壁に対して摺動しているのか固着しているのかをニューラルネット によって判別し適当な数学モデルを切換えて制御するシステムを提案し、従来 では困難であった空気圧シリンダの位置制御の高精度化を可能とした.

第3章では、光を直接流体信号に変換する方式として光信号により境界層を 制御する光流体変換器を開発した。光流体変換器は光エネルギを光吸収体で熱 エネルギにいったん変換し空気の粘性を変化させて光エネルギからアナログ的 に流体エネルギに直接変換するものである。しかし、光流体変換器における噴 流の温度分布の変化と、それに伴う速度分布の変化が解明されなくては効率的 な設計は不可能である。そこで、数値流体解析法として温度変化による粘性の 変化を考慮に入れた Simplified Marker And Cell method を用いて理論解析を おこない光流体変換器内の温度分布と速度分布を明らかにした。次に、変換器 の拡大モデルを製作し変換器の出力特性,温度分布特性・速度分布特性の測定 を行った.そして,実験結果と解析結果を比較し提案した理論解析モデルが妥 当なものであることを明らかにした.また,光エネルギから流体エネルギへ直 接変換するデバイスとして十分な特性を有していることを実験から明らかにし た.

第4章では、光流体サーボシステムの実用化を目指し、ロボットアームの光 制御,圧力の光制御をおこなった.光流体変換器からの出力は、圧力、流量と もに微小であるため、圧力増幅器を使用する必要がある、まずノズルフラッパ 方式の圧力増幅器を用いてロボットアームの制御を行った.しかし、まだ得ら れる出力圧力が低いための問題点があった.これらの点について改善するため に, 最適制御と外乱オブザーバを用いた P 制御を行った. 最適制御, 外乱オブ ザーバともにPID制御に比べ格段に優れた制御性能が得られた、外乱オブザ ーバについては、制御対象とノミナルモデルのパラメータのずれとその変動を すべて外乱としてとらえることにより、出力圧力が小さいことに起因する摩擦 力の影響などの非線形性を補償することができ優れた制御性能が得られた. し かし、ノズルフラッパ式の圧力増幅器はゲインが高く特性が不安定である、小 型軽量化が難しいなどの欠点があった.そこで.光流体変換器からの出力圧力 で駆動するサーボ弁を圧力増幅器として使用し光流体変換器と組み合わせた光 流体圧力制御サーボシステムを開発した。この装置は信頼性が高く、高い出力 圧力を得られるため今後の開発の中心的存在になっていくと考えられる.まだ 整定時間が長いなどの解決すべき点があるが 0.2MPa 程度のほぼ実用的な圧力レ ベルが得られており、今後光流変換部の変換ゲインの見直しなどの改良により 光流体制御システムが一挙に実用化される可能性を見出した.

参考文献

- 大皿,則次,橋本,高岩:ゴム人工筋マニピュレータを用いたパワー アシストシステム 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演 会講演論文集,1997-B,973/974,(1997)
- 2) 則次:ゴム人工筋を用いたリハビリテーション支援ロボット,油圧と 空気圧, 28-1,29/34, (1997)
- 3) 荒木:看護婦にやさしいサポートカーの開発,油圧と空気圧,28-1,76/82 (1997)
- 4) 山本:空圧式ホームエレベーターの開発,油圧と空気圧, 36-9, 3
 8/45 (1997)
- 5) 白石,奥田:インテリジェント義足の空気圧シリンダの応用,平成10 年春季油空圧講演会講演論文集,107/108,1998
- 6) 羽鳥:医療福祉機器研究開発制度と産学官による研究開発について、 油圧と空気圧、28-1,14/19,(1997)
- 7) 山本,兵頭:介護用パワードスーツの開発,流体制御シンポジウム講演論文集,10th,131/136,(1995)
- 8) 中田,曹,木村,謝:光サーボシステムの基礎的研究,日本機械学会論 文集(C編),58-552,189/194,(1992)
- 9) Bell, A.G : On the Productionand Reproduction of Sound by Li ght, Trans American Association for the Advancement of Scien ce, (1880)
- 10) J.O.Gurney, Jr : Photofluidic Interface, Trans. ASME, Journal of D.S.M.C., 160-3, 90/97, (1984)
- Drzewiecki : Fluidic Guidance for Space-Base Kinetic Energy Weapon Projectiles, Proceedings of 13th Triennial Internatio nal Symposium on Fluid Control, 303/311, (1991)
- 12) 堂田,東海,高森:光-流体変換素子に関する研究,計測自動制御学会 論文集,26-7,780/786,(1990)
- 13)山本:光 流体制御素子の開発,第4回流体制御シンポジウム講演論 文集,(1989)
- 14) 則次:空気圧制御の新しい展開,システム/制御/情報,39-2,67/73, (1995)
- 15) 鹿島:直動空気圧サーボ弁による制御例,油圧と空気圧,26-2,70/74, (1995)
- 16) WONG, PU, MOORE: Methods of Overcoming Friction Effects in the Control of Pneumatic Servo Systems, Am Soc Mech Eng Fluid Pow er Syst Technol Div, 2,139/144, (1995)
- 17) 竹下,田中,清水,柴田,山本: 空気圧サーボ系の最小分散型適応極配置制御,日本機械学会全国大会講演論文集,73-4,300/301,(1995)
- 18) 則次, 高岩:外乱オブザーバを用いた空気圧サーボ系のインピーダンス制御 計測自動制御学会論文集, 30-6, 677/684, (1994)

- 19) 青木 橋本 今枝 喜羽:ニューラルネットワークによるゴム人工筋ア クチュエータの位置・力制御,平成10年秋季油空圧講演会講演論文集, 112/114,(1996)
- 20) YANG Q-H, 川上,河合: パルス幅変調方式による空気圧シリンダの 位置制御に関する一考察,油圧と空気圧, 27-6,803/809, (1996)
- 21) VAN VARSEVELD R B, BONE G M: Accurate Position Control of a Pneumatic Actuator Using On/Off Solenoid Valves, IEEE/ASME T rans Mechatron, 2-3, 195/204, (1997)
- 22) 鈴木,古屋,長田佐,大内:超音波 PWMバルブによる空気圧シリンダの 位置および力制御,精密工学会誌, 61-9,1322/1326, (1995)
- 23) WACHOWIAK J:Konzept eines quasiproportionalen pneumatischen Mikroventils, Oelhydraul Pneum, 39-8, 628/630, (1995)
- 24)橋本 松熊 石田:非線形PID補償器による空気圧シリンダの位置決め制御,平成9年秋季油空圧講演会講演論文集,66/68,(1995)
- 25) 早川 鴨山 永瀬:スライディングモード制御を用いた空気圧アクチュエータ,平成10年春季油空圧講演会講演論文集, 55/57,(1996)
- 26) 栗田 石田:スミス型むだ時間補償器を用いたI-PD型適応極配置,平 成10年秋季油空圧講演会講演論文集,133/135,(1998)
- 27)前田川上 中野:空気圧リフタの位置制御,平成9年秋季油空圧講演 会講演論文集, 69/71,(1995)
- 28) 荒木,棚橋:空気圧シリンダの摩擦がストローク特性に及ぼす影響, 昭和55年秋季油空圧講演会講演論文集,23/26,(1980)
- 29) 大司,川嶋,大上,中沢:空気圧シリンダの高精度中間位置停止に関する研究,日本機械学会・精密工学会山梨講演会講演論文集,1995,1 71/172,(1995)
- 30) NGUYEN:Optimierung pneumatischer Druckregelkreise mittels de r Fuzzy-Set-Logik, Oelhydraul Pneum, 39-4, 283/284, (1995)
- 31) 山本,大内,長田:積層圧電アクチュエータを利用した空気圧オンオ フ弁,平成10年秋季油空圧講演会講演論文集,124/126,(1998)
- 32) N.S.Scavarda, M.Betemps, A.Jutard: Models of a Pneuumatic PWM s olenoid valve for Engine-ering Applications, J. of D.S.M.C., V ol. 114, 680/688(1992)
- 33) 揚,川上,河合:パルス変調方式による空気圧シリンダの位置制御に
 関する一考察,油圧と空気圧,27-6,803/809(1995)
- 34) 則次:パルス変調方式による電気空気圧サーボ機構の研究,計測自動制御学会論文集,20-8,754/761(1984)
- 35) S.G.Lee, H.S.Cho:On the Development of a PWM Control-Based Pn eumatic Servochanisms, Proc. of Fluid Control and Measurement, Vol. 159/65(1986)
- 36) 小山, 密田, 原田: 電気空気圧サーボ方式によるピストンシリンダ の位置決め, 油圧と空気圧, 16-4, 55/60(1985)

- 37)小山,原田:高応答電磁弁を使った圧力サーボ機構,油圧と空気圧, 20-4,344/349(1989)
- 38)小山,片桐,川島,香川:電磁弁直動空気圧レギュレータのリップ ル低減,油圧と空気圧,28-6,673/678(1997)
- 39)小山, 香川, 安達, 原田:電磁弁を使った空気圧レギュレータの負荷への適応, 油圧と空気圧, 22-7, 800/806(1991)
- 40) 則次,高岩:外乱オブザーバを用いた空気圧位置決め制御系の設計 計測自動制御学会論文集 31-1,82/88 (1995)
- 41) 松崎,張,川島,藤田,香川:等温化圧力容器を用いた減圧弁の 流量特性試験法 平成7年秋季油空圧講演会講演論文集 65/68(1995)
- 42) 市川, 金井, 鈴木, 田村: 適応制御 昭晃堂(1984)
- 43) 吉満,小山,片桐:電磁弁の過渡特性を用いた高精度空気圧レギュレータ 平成9年春季油空圧講演会講演論文集 81/84(1997)
- 44) 小山, 片桐, 川島, 香川:電磁弁直動空気圧レギュレータのリップ ル低減, 油圧と空気圧, 28-6, 673/678(1997)
- 45)小山,香川,藤野,清水:ラビリンスシールシリンダを使った空気圧サーボ系の駆動について,計測自動制御学会論文集 28-6,690/696(1992)
- 46)小山,原田,山口,高橋:空気圧シリンダの粘弾性を考慮した位置決め 制御,平成4年春季油空圧講演論文集 57/60(1992)
- 47) 高橋,天野,小山,原田:空気圧シリンダの粘弾性特性に関する研究, 平成5年秋季油空圧講演論文集 101/104(1993)
- 48) 高橋
 他:空気圧シリンダの粘弾性特性に関する研究,平成5年秋季
 油空圧講演会100/103(1993)
- 49) 天野 他:空気圧シリンダの粘弾性特性に関する研究,平成6年秋季
 油空圧講演会73/76(1994)
- 50) 佐々木 他:空気圧シリンダ変位の粘弾性特性,平成8年春季油空圧 講演会49/52(1996)
- 51)飯塚 他:空気圧シリンダの粘弾性特性に関する研究,平成8年秋季油空圧講演会85/121(1996)
- 52) 吉満,小山:空気圧シリンダの粘弾性特性に関する研究,平成9年
 秋季油空圧講演会
- 53) T.M.Drzewiecki, "Fluerics 38 A Computer-Aided Design Analysis for the Static and Dynamic Port Characteristics of Laminar Proportional Amplifier", HDL-TR-1758, Harry Diamond Labs., June (1976)
- 54) 山本:光 流体制御素子の特性,第5回流体制御シンポジウム講演論 文集,85/88,(1990)
- 55) 山本:流体素子の出力特性モデル,第5回流体制御シンポジウム講演 論文集,89/92,(1990)

- 56) 山本:光信号による空気圧ロボットアームの制御,平成3年秋季油空 圧講演会講演論文集,61/64,(1991)
- 57) Gurney, Jr., J.O., Photofluidic Interface, Trans.ASME, J.D.S.M.&C., 106, March (1984)
- 58) 山本:光音響を利用した光-流体変換素子,第2回流体制御シンポジウム,73/78(1987)
- 59) Yamamoto, K., et al., Opto-Fluidic Control Device, Proc. of 1st JHPS Symposium on Fluidic Power, 333/338(1989)
- 60) 堂田:光 流体変換素子に関する研究,計測自動制御学会論文集,26-7,780/786,(1990)
- 61) 山本:光 流体制御素子の開発 第4回流体制御シンポジウム講 演論文集 149/152, (1989)
- 62) 大澤,原田,山本:光制御空気圧ロボットアーム 平成5年秋季油
 空圧講演論文集,93/96,(1993)
- 63) 三上,小山,山本:光制御ロボットアームに関する研究 第9回流
 体制御シンポジウム講演論文集,51/56(1994)
- 64) 美多 勉 著 デジタル制御理論 昭晃堂

本論文に関する発表

印刷論文

- 1. Keijiro YAMAMOTO, Osamu OYAMA, Toshihiro YOSHIMITSU: Optical Control System, Proceedings of Fifth Triennial International Symposium on Fluid Control, 541/544, (1998)
- 2. 吉満 俊拓, 片桐 一博, 香川 利春, 小山 紀:電磁弁の浮動状態により制御される空気圧レギュ レータ, 日本油空圧学会論文集, 29-7,7/12,(1998)
- 3. 小山 紀, 天野 景範, 飯塚 健太呂, 吉満 俊拓:空気圧シリンダ変位の粘弾性特性と制御性能 への影響, 日本油空圧学会論文集, 29-7, 19/24, 1998
- Toshihiro YOSHIMITSU, Osamu OYAMA, Keijiro YAMAMOTO :Characteristic of Opto-fluidic Control System, Proceeding of the Fourth JHPS International Symposium on Fluid Power Tokyo'99, 431/436, (1999)
- Osamu OYAMA, Toshihiro YOSHIMITSU:Minimal Time Control of Pneumatic Cylinder and it's Performance, Proceeding of the Fourth JHPS International Symposium on Fluid Power Tokyo'99, 685/671, (1999)

口頭発表

- 1. 吉満 俊拓, 片桐 一博, 香川 利春, 小山 紀:電磁弁の過渡特性を用いた高精度空気圧レギュレ ータ, 春季油空圧講演会講演論文集, 81/84(1997)
- 吉満 俊拓,小山 紀:最短時間制御と組み合わせた空気圧シリンダの適応制御,SICE97 第 36 回学術講演会予稿集,597/598(1997)
- 3. 吉満 俊拓,小山 紀:電磁弁駆動空気シリンダの最短時間最小エネルギ制御,春季油空圧講演 会講演論文集,52/54(1998)
- 4. 吉満 俊拓,小山 紀:電磁弁の過渡特性を用いた高精度空気圧サーボ系,SICE98 第 37 回学術 講演会予稿集,237/238(1998)
- 5. 吉満 俊拓, 香川 利春, 小山 紀:電磁弁と等温化圧力容器を用いた流量サーボシステム, 秋季 油空圧講演会講演論文集, 139/141(1998)
- 6. 吉満 俊拓,小山 紀:空気圧シリンダシールの摺動・非摺動状態の判別と制御,第13回流体制 御シンポジウム講演論文集,89/92(1998)
- 7. 片山 活之,山本 圭治郎,小山 紀,吉満 俊拓:光流体システムに関する研究,第13回流体 制御シンポジウム講演論文集,57/60(1998)
- 8. 吉満 俊拓,山本 圭治郎,小山 紀:数値流体解析法を用いた光流体素子の温度・速度場解析, 春季油空圧講演会講演論文集,121/123(1999)
- 9. 武田 義寛, 吉満 俊拓, 小山 紀:空気圧歩行支援システムの開発,春季油空圧講演会講演論文 集, 100/103(1999)
- 10. 吉満 俊拓,小山 紀,山本 圭治郎:光流体制御システムに関する研究,第14回流体制御シン ポジウム講演論文集,1/4(1999)
- 11.片山 活之, 吉満 俊拓,小山 紀, 山本 圭治郎:空気圧駆動ロボットアームの光流体制御に関す る研究, 第 14 回流体制御シンポジウム講演論文集, 5/9(1999)

本研究を進めるうえで、貴重なご意見、ご指導を賜りました明治大学理工学 部教授 清水 茂夫氏,伊藤 光氏,助教授 小山 紀氏、LPAの分野においてご 指導を賜りました神奈川工科大学教授 山本 圭治郎氏に感謝の意を申し上げま す。

また、共に本研究を遂行し、ご助言を頂きました明治大学大学院2年 片山活 之氏、同大学院1年 武田 義寛氏、今泉 辰彦氏、また多くのご協力を頂きまし た同大学院2年 永井 将光氏、山田 宏道氏、実際に本研究に対し援助して頂い た同大学4年 須志原 友和氏、五十嵐 睦氏、本間 憲氏, 荻原 泰史氏他 メカ トロニクス研究室ゼミ生諸君に感謝の意を申し上げます。

> 1999年12月 著者